PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFEIT AUF DEM GEBIET DES PATENT WESSEN VON 1NTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENT WESSEN VON 1NTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENT WESSEN VON 1990 (11) Internationale Patentklassifikation 7: (20) Internationales Aktenzeichen: (21) Internationales Aktenzeichen: (22) Internationales Anmeldedatum: (23) Internationales Anmeldedatum: (24) Internationales Anmeldedatum: (25) Internationales Anmeldedatum: (26) Internationales Anmeldedatum: (27) Internationales Anmeldedatum: (28) Internationales Anmeldedatum: (29) Internationales Anmeldedatum: (20) Internationales Anmeldedatum: (21) Internationales Anmeldedatum: (22) Internationales Anmeldedatum: (23) Internationales Veröffentlichungsnummer: (24) Internationales Veröffentlichungsnummer: (25) Internationales Aktenzeichen: (26) Internationales Anmeldedatum: (27) Internationales Anmeldedatum: (28) Internationales Veröffentlichungsnummer: (29) Internationales Aktenzeichen: (29) Internationales Antenzeichen: (29) Internationales Antenzeichen: (20) Internationales Veröffentlichungsnummer: (20) Internationales Aktenzeichen: (21) Internationales Veröffentlichungsnummer: (22) Internationales Aktenzeichen: (23) Internationales Veröffentlichungsdatum: (24) Internationales Veröffentlichungsdatum: (25) Internationales Aktenzeichen: (26) Internationales Aktenzeichen: (27) Internationales Aktenzeichen: (28) Internationales Veröffentlichungsdatum: (29) Internationales Aktenzeichen: (29) Internationales Veröffentlichungsdatum: (20) Internationales Aktenzeichen: (21) Internationales Veröffentlichungsdatum: (21) Internationales (A. A. B. C. G. C.	INTERNATIONALE ANMELDUNG V	EROF BEIT A	AUF D	EM GEBIET DES PATENTY	wee: WO 00/39027
Veröffentlichungsdatum: (21) Internationales Aktenzeichen: (22) Internationales Anmeldedatum: (23) Internationales Anmeldedatum: (24) Internationales Anmeldedatum: (25) Internationales Anmeldedatum: (26) Internationales Anmeldedatum: (27) Internationales Anmeldedatum: (28) Internationales Anmeldedatum: (29) Internationales Anmeldedatum: (29) Internationales Anmeldedatum: (20) Internationales Anmeldedatum: (21) Internationales Anmeldedatum: (22) Internationales Anmeldedatum: (23) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.12.98) DE (25) Internationales Anmeldedatum: (26) Internationales Anmeldedatum: (27) Prioritätsdaten: (28) GR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DK, ER, FI, FR, GR, GB, GR, GR, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA ME, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, TR, TT, TZ, UA, UC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, SE, ST, TZ, UG, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TI, TM, SE, ST, TT, TM, SE, ST, TT, TM, SE, ST, TM, SE, ST, TM, SE, ST, TM, SE, ST, TT, TM, SE, ST, TM, SE, ST, TM	INTERNATIONALE ZUSAMME		(11) Ir	nternationale Veröffentlichungsnu	
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/09915 (22) Internationales Anmeldedatum: 14. Dezember 1999 (14.12.99) (14.12.99) (30) Prioritätsdaten: 198 60 146.8 24. Dezember 1998 (24.12.98) DE 198 60 146.8 24. Dezember 1998 (24.12.98) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-51368 Leverkusen (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BLOCK, Hans-Dieter (DE/DE]; Biesenbach 49, D-51381 Leverkusen (DE). LEIMKÜHLER, Hans-Joachim [DE/DE]; Saarstrasse 41, LEIMKÜHLER, Hans-Joachim [DE/DE]; Saarstrasse 41, LEIMKÜHLER, Hans-Joachim [DE/DE]; Saarstrasse 41, D-51375 Leverkusen (DE). MÜLLER, Dirk [DE/DE]; SCHÄFER, Johannes-Peter [DE/DE]; RONGE, Georg Strasse 368a, D-51515 Kürten (DE). RAYER AKTIENGE-	31) Internationale Patentiassimus-	A1	(43) I	nternationales	6. Juli 2000 (06.07.00)
FOR PRODUCING SILANE	21) Internationales Aktenzeichen: (22) Internationales Anmeldedatum: (23) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser USATIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-51368 (DE). (27) Erfinder; und (27) Erfinder; und (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (25) Aktiender (für alle Bestimmungsstaaten ausser USATIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-51368 (DE). (27) Erfinder; und (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (25) Prioritätsdaten: (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (24) Dezember 1998 (24.1) (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (24) Dezember 1998 (24.1) (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (20) Prioritätsdaten: (24) Dezember 1998 (24.1) (24) Prioritätsdaten: (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (20) Prioritätsdaten: (20) Prioritätsdaten: (20) Prioritätsdaten: (21) Prioritätsdaten: (22) Prioritätsdaten: (24) Prioritätsdaten: (25) Prioritätsdaten: (26) Prioritätsdaten: (27) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (28) Prioritätsdaten: (29) Prioritätsdaten: (20) Prioritätsdaten: (21) Prioritätsdaten: (21) Prioritätsdaten: (21) Prioritätsdaten: (22) Prioritätsdaten: (27	mber 1 (14.12 2.98) 5): BA Leverl kusen aarstras irk [D] dbach Wipper NGE, dorf (L	DE YER Kusen Dieter (DE). see 41, E/DE]. fürther Georg DE. TENGE-	AE, AL, BG, BR, BY, CA, CH, CN, GES, FI, GB, GD, GE, GH, GE, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, MD, MG, MK, MN, MW, MSD, SE, SG, SI, SK, SL, MS, UZ, VN, YU, ZA, ZW, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ (AM, AZ, BY, KG, KZ, Patent (AT, BE, CH, CY, IE, IT, LU, MC, NL, PT, CG, Cl, CM, GA, GN, GW. Veröffentlicht Mit internationalem Reche Vor Ablauf der für Änderu Frist; Veröffentlichung weintreffen.	KM, HR, HU, ID, IL, IL, IL, IL, IL, IL, IL, IL, IL, IL

- (54) Title: METHOD AND SYSTEM FOR PRODUCING SILANE
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND ANLAGE ZUR HERSTELLUNG VON SILAN

According to the invention, silane is produced in a continuous method by dismutating trichlorosilane in a catalyst bed at a temperature ranging from -20° to 50 °C.

Silan wird in ein kontinuierliches Verfahren durch Disproportionierung von Trichlorsilan in einem Katalysatorbett im Druckbereich (57) Zusammenfassung von -20° bis 50°C hergestellt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Stowenien
\mathbf{AM}	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Słowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
\mathbf{AU}	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
вв	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	ТJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	ΙL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Istand	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	ΙT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

PCT/EP99/09915 WO 00/39027

Verfahren und Anlage zur Herstellung von Silan

Die vorliegende Erfindung betrifft ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Silan SiH₄ durch katalytisches Disproportionieren von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid SiCl₄. Gegenstand der Erfindung ist auch eine Anlage zur Durchführung des Verfahrens.

SiH₄ ist ein hervorragend geeignetes Ausgangsmaterial, aus dem, gegebenenfalls nach weiterer Reinigung, durch thermische Zersetzung sehr reines Silicium in Halbleiterqualität abgeschieden werden kann. Der Bedarf an Reinst-Silicium wächst stark und damit der Bedarf an reinem Silan, dessen hervorragende Eignung zur Reinst-Silicium-Erzeugung immer mehr erkannt und genutzt wird.

Unter den in der Literatur beschriebenen Verfahren zur Herstellung von Silan ist die Erzeugung aus Trichlorsilan durch Disproportionierung wirtschaftlich vorteilhaft. Bekannt ist es, daß Amine, speziell tertiäre Amine und ihre Hydrochloride und quartäre Ammoniumchloride, sowohl in flüssiger (DE 3 500 318) als auch in fester Form, z.B. an feste Träger gebunden, als Katalysatoren die Disproportionierung des Trichlorsilans in wirtschaftlich vorteilhafter Weise beschleunigen. An feste Träger gebundene Amine (US 4 701 430, US 5 026 533, DE 3 500 318, DE 3 311 650) werden vorzugsweise deshalb eingesetzt, weil damit der Eintrag von verunreinigenden Aminen in die reagierende gasförmig-flüssige Silan-Chlorsilan-Phase vermieden werden kann.

25

30

20

5

10

15

Die in einigen anderen beschriebenen Verfahren gewählten flüssigen Katalysatoren haben den Nachteil, daß sie über die Zeit langsam aus dem Reaktionsteil ausgetragen werden, da sie niemals vollständig von den Reaktionsprodukten abgetrennt werden können. Die mitgeschleppten Katalysatormengen führen in nachfolgenden Verfahrensschritten oder in einem Kreislaufsystem auch in vorgeschalteten Verfahrensschritten zu Problemen, weil sie sich an bestimmten Stellen des Systems sammeln

WO 00/39027 PCT/EP99/09915

können und dort z.B. unerwünschte Reaktionen katalysieren können. Auch gelingt es mit einem flüssigen Katalysator nicht, diesen möglichst gleichmäßig in der Kolonne zu verteilen, sondern er wird sich aufgrund seines spezifischen Dampfdrucks lokal aufkonzentrieren. Dieses Problem wird durch die in DE 3 500 318 vorgeschlagene Verwendung zweier Katalysatoren mit unterschiedlichen Siedepunkten keinesfalls behoben, sondern allenfalls gemindert.

5

10

15

20

25

30

Es ist auch bereits versucht worden, die nach dem Stand der Technik in mehreren Schritten, beispielsweise in zwei Schritten ablaufende Disproportionierung in einem Schritt nach dem Prinzip der Reaktivdestillation ablaufen zu lassen. Die Reaktivdestillation ist durch Kombination von Reaktion und destillativer Trennung in einem Apparat, insbesondere einer Kolonne gekennzeichnet. Durch die fortlaufende destillative Entfernung der jeweils leichtest siedenden Komponente in jedem Raumelement wird stets ein optimales Gefälle zwischen Gleichgewichtszustand und tatsächlichem Gehalt an leichter siedenden Komponenten bzw. leichtest siedender Komponente aufrecht erhalten, so daß eine maximale Reaktionsgeschwindigkeit resultiert (JP-01 317 114).

Aus der DE 2 507 864 ist ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Silan bekannt, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man in ein Bett eines im Reaktionsmedium unlöslichen Anionenaustauscherharzes, enthaltend tertiäre Amino- oder quaternäre Ammoniumgruppen an einem Kohlenstoffatom, Trichlorsilan einführt und die Temperatur des Harzbettes so hält, daß Trichlorsilan disproportioniert wird einerseits zu Produkten, die im Bett aufsteigen, und andererseits zu Siliciumtetrachlorid, das kondensiert und zum Kolonnensumpf fließt, und daß man die Temperatur am oberen Teil des Bettes über dem Siedepunkt von Silan und unter dem Siedepunkt von Monochlorsilan hält und das von Chlorsilanen praktisch freie Silan aus dem Bett gewinnt.

Dieses Verfahren zeichnet sich den anderen bekannten Verfahren gegenüber dadurch aus, daß es

wo 00/39027 - 3 -

(1) apparativ einstufig ist, also Silan und Siliciumtetrachlorid als gewünschte, angereicherte Produkte von verschiedenen Stellen des gleichen Apparates zu entnehmen gestattet, das also mit vergleichsweise geringem apparativen Aufwand und reduziertem Energieeinsatz auskommt, daß es

PCT/EP99/09915

5

die Produkte Silan (in Konzentrationen zwischen 96 bis 98 % SiH₄) und Siliciumtetrachlorid (in Konzentrationen z.B. zwischen 70 bis 80 % SiCl₄) in vergleichsweise hoher Konzentration zu erzeugen gestattet, ohne weitere Hilfsaggregate zu benötigen, daß es

10

15

25

30

dank des festen unlöslichen Katalysators (im weiteren katalytisch wirksamer Feststoff genannt) nur minimalen Eintrag von Verunreinigungen aus dem Katalysator in die Reaktionsmischung aufweist und im Vergleich zu den flüssigen löslichen Katalysatoren einen deutlich geringeren Trennaufwand für die Abtrennung der Katalysatoren erfordert und auch die Ansammlung von flüchtigen, flüssigen Katalysatoren an bestimmten Kolonnenteilen strikt vermeidet und daß es

(4) durch das Prinzip der Reaktivrektifikation den Energieaufwand für die
 Trennung der in den einzelnen Gleichgewichtsstufen der Disproportionierung entstehenden Silane oder Chorsilane minimiert.

Allerdings besteht ein schwerwiegender Nachteil dieses in der DE 2 507 864 beschriebenen Verfahrens darin, daß der für die Trennung der Silane oder Chlorsilane aufgewendete Energiebetrag vollständig auf einem den Kondensationstemperaturen entsprechenden sehr niedrigen Temperaturniveau abgeführt werden muß. Am Kopf entsprechenden sehr niedrigen Temperaturniveau abgeführt werden muß. Am Kopf der Kolonne muß nach DE 2 507 864 nämlich eine Temperatur unterhalb der Kondensationstemperatur von Monochlorsilan SiH₃Cl eingestellt werden und im Bereich des Einlaufs von Trichlorsilan SiHCl₃ eine Temperatur, die die Verdampfung des Trichlorsilans ermöglicht. Somit wird die zur Verdampfung der verschiedenen Chlorsilane und des Silans in den einzelnen Abschnitten der Kolonne erforderliche Energie

PCT/EP99/09915

- 5 -

Geeignete katalytisch wirksame Feststoffe sind bekannt und auch in der DE 2 507 864 beschrieben. Es sind beispielsweise solche Feststoffe, die an einem Gerüst aus Polystyrol, vernetzt mit Divinylbenzol, Amino- oder Alkylenamino-Gruppen wie Dimethylamino-, Diethylamino-, Ethylmethylamino-, Di-n-propylamino-, Di-i-propylamino-, Di-2-Chlorethylamino-, Di-2-Chlorpropylamino-Gruppen und deren Hydrochloride oder aber die durch Methylierung, Ethylierung, Propylierung, Butylierung, Hydroxyethylierung oder Benzylierung und daraus gebildete Trialkylammonium-Gruppen mit Chlorid als Gegenion enthalten. Selbstverständlich können im Fall quartärer Ammoniumsalze oder protonierter Ammoniumsalze auch katalytisch wirksame Feststoffe mit anderen Anionen, z.B. Hydroxid, Sulfat, Hydrogensulfat, Bicarbonat u.a. in das erfindungsgemäße Verfahren eingeführt werden, eine Umwandlung in die Chloridform ist unter den Reaktionsbedingungen mit der Zeit aber unvermeidbar, was auch für organische Hydroxygruppen gilt.

Ebenso sind geeignet Feststoffe, die aus einem Polyacrylsäure-Gerüst, speziell einem Polyacrylamid-Gerüst bestehen, das z.B. über eine Alkylgruppe Trialkylbenzylammonium gebunden hat.

Eine andere für das erfindungsgemäße Verfahren geeignete Gruppe katalytisch wirksamer Feststoffe sind solche, die an einem Polystyrol-Gerüst, vernetzt mit Divinylbenzol, Sulfonat-Gruppen angebunden haben, denen als Kationen tertiäre oder quartäre Ammoniumgruppen gegenüberstehen.

Im Regelfall sind makroporöse oder mesoporöse Austauscherharze besser als Gelharze geeignet. Weitere geeignete katalytisch wirksame Feststoffe sind solche, die auf einem festen anorganischen Gerüst wie Kieselsäure oder Zeolith angebundene organische Aminogruppen der obengenannten Art, z.B. solche mit einer 3-Siloxypropyldimethylamino-Gruppe, tragen (US 4 701 430). Die geeigneten, katalytisch wirksamen Feststoffe werden üblicherweise in Perlform eingesetzt.

5

10

20

25

WO 00/39027 - 7 -

kolonne 1 mit einem reaktiv/destillativen Reaktionsbereich 2 zur katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ aufweist. Die Disproportionierung im Reaktionsbereich 2 erfolgt in einem Katalysatorbett 2', das aus einer für die Disproportionierungsprodukte durchströmbaren Schüttgutschicht aus Festkörpern aus katalytisch nierungsprodukte durchströmbaren Schüttgutschicht können im Reaktionswirksamen Feststoffen besteht. Statt einer Schüttgutschicht können im Reaktionswirksamen bereich auch gepackte Katalysatorkörper vorgesehen sein. Als katalytisch wirksame bereich auch gepackte Katalysatorkörper vorgesehen sein. Als katalytisch wirksame Feststoffe werden bevorzugt in der DE 2 507 864 beschriebene Feststoffe eingesetzt, wie sie oben angegeben sind.

PCT/EP99/09915

Das SiHCl₃ wird der Reaktionskolonne 1 über einen Zulauf 3 zugeführt, der in die Kolonne an geeigneter Stelle mündet. Im Reaktionsbereich 2 wird durch Disproportionierung von SiHCl₃ ein SiH₄-haltiges, im Reaktionsbereich aufsteigendes Produktgemisch, und ein SiCl₄ enthaltendes, im Reaktionsbereich abströmendes Kondensat gebildet.

15

20

25

30

5

Das aus dem Reaktionsbereich austretende SiCl₄ enthaltende Kondensat wird in der Reaktionskolonne 1 in einen unterhalb des reaktiv/destillativen Reaktionsbereichs 2 angeordneten destillativen Abtriebsteil 4 eingeführt, unter dem sich dann ein Sumpfaredampfer 5 befindet, aus dem als Sumpfprodukt Siliciumtetrachlorid SiCl₄ über verdampfer 5 befindet, über den Wärmetauscher 5 erfolgt der erforderliche einen Abfluß 13 abfließt. Über den Wärmetauscher 5 erfolgt der erforderliche Wärmeeintrag in die Reaktionskolonne zur Disproportionierung von SiHCl₃.

Für das im Reaktionsbereich 2 aufsteigende SiH₄-haltige Produktgemisch ist oberhalb des Reaktionsbereichs ein Zwischenkondensator 6 vorgesehen, in dem durch Teilkondensation von schwerer siedenden Komponenten bei einer Temperatur zwischen -25°C und 50°C, bevorzugt zwischen -5°C und 40°C, die Konzentration von SiH₄ im Produktgemisch erhöht wird. Die Kondensationswärme wird von einem den Zwischenkondensator 6 durchströmenden Kühlmedium abgeführt. Die im Zwischen-Zwischenkondensator 6 nicht kondensierten, leichter siedenden Produktanteile werden zur konzentrationserhöhung in einen dem Zwischenkondensator in Strömungsweiteren Konzentrationserhöhung in einen dem Zwischenkondensator 7 zugerrichtung der aufsteigenden Produktanteile nachgeschalteten Verstärkerteil 7 zugerrichtung der aufsteigenden Produktanteile nachgeschalteten Verstärkerteil 7 zuger

Der Verstärkerteil 7 samt zugehörigem Kopfkondensator 9 kann auch außerhalb der Reaktionskolonne 1 extern angeordnet sein.

Bei den üblicherweise angewendeten Drücken von 1 bis 50 bar, bevorzugt 1 bis 10 bar, und den gewünschten Reinheiten des Silanprodukts ist der Kopfkondensator 9 unterhalb der Kondensationstemperaturen von < - 40°C, meist sogar unter < -60°C zu betreiben. Durch die Installation rein destillativer Trennabschnitte vor Kondensation des Silan-Endprodukts und das Anordnen eines destillativen Abtriebsteils 4 oberhalb des Sumpfverdampfers 5 wird die eingetragene Energie mehrfach genutzt, und zwar (1) zur Reinigung und Konzentrierung des Silans im Verstärkerteil 7, (2) zur ständigen destillativen Entfernung der bezogen auf die jeweiligen lokalen apparativen Verhältnisse leichter siedenden Zwischenprodukte bzw. Produkte und damit zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich 2, und (3) zur Reinigung des SiCl4 im unteren Teil der Reaktionskolonne. Durch den destillativen Abtriebsteil 4 und die dadurch mögliche Reinigung des am Sumpf entnommenen SiCl₄ entsteht ein weiterer Vorteil gegenüber dem aus DE 2 507 864 bekannten Verfahren, weil eine nachfolgende Kolonne zur Reinigung des SiCl₄ entfallen kann und somit auch für diesen Verfahrensschritt erforderliche Energie eingespart wird.

20

25

30

15

5

10

Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist in Figur 2 dargestellt. Bei diesem Beispiel entspricht die Reaktionskolonne 1a in ihrem Aufbau weitgehend der Ausbildung der Reaktionskolonne 1 nach Figur 1. Alle Apparateteile, die analog den Teilen nach Figuren 1 und 2 gestaltet sind, werden deshalb mit gleichen Bezugszeichen, jedoch zur Unterscheidung jeweils mit angefügtem Index "a" angegeben.

Die Trennkolonne 14 ist beim Ausführungsbeispiel nach Figur 2 einem Kondensator 9a nachgeschaltet, der zwischen Verstärkerteil 7a und Trennkolonne 14 angeordnet ist. Im Kondensator 9a wird das aus dem Verstärkerteil 7a über den Abzug 8a abströmende, nicht kondensierte SiH₄-haltige Produktgemisch vor Eintritt in die Trennkolonne 14 zumindest zu einem Teil kondensiert, so daß in die Trennkolonne

PCT/EP99/09915

vorzugsweise 15 bar bis 100 bar, eingestellt ist, so daß die Trennkolonne 14 folglich bei höheren Temperaturen, bezogen auf gleiche Zusammensetzung, arbeitet als die Reaktionskolonne 1a. Auch bei dieser Variante kann das Sumpfprodukt der getrennt stehenden Trennkolonne 14 abhängig von den gewählten Betriebsbedingungen große stehenden Trichlorsilan, Dichlorsilan und Monochlorsilan enthalten. Das Sumpfprodukt Anteile Trichlorsilan, Dichlorsilan und Monochlorsilan enthalten. Das Sumpfprodukt wird über die am Abzug 24 angeschlossene Zweigleitung 25 ganz oder teilweise in die Reaktionskolonne 1a zurückgeführt. Durch Ausschleusen eines Teilstroms können gegebenenfalls Verunreinigungen aus dem System entfernt werden (28).

Die Zulaufmenge oder die Zulaufmengen in die Reaktionskolonne über die Zuleitungen 3, 3a und 25, werden gegebenenfalls nach Vorreaktion in einem Vorreaktor in Abhängigkeit von der jeweiligen Zusammensetzung in den Abtriebsteil 4, 4a oder zwischen reaktiv/destillativen Reaktionsbereichen 2, 2a und Abtriebsteil oder in die reaktiv-destillative Reaktionszone oder in den Zwischenkondensator 6, 6a geführt.

15

20

5

10

Das erfindungsgemäße Verfahren wird bei Drücken von 1 bis 50 bar, vorzugsweise 1 bis 10 bar, besonders bevorzugt 2,8 bis 5 bar, im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich mit katalytisch wirksamen Feststoffen betrieben. Mit den Drücken werden die Temperaturen im System beeinflußt. Die Temperaturen in demjenigen Abschnitt des reaktiv/destillativen Reaktionsteils, in dem die Disproportionierung stattfindet, liegen zwischen 30°C und 180°C, vorzugsweise zwischen 50°C und 110°C. Die jeweils einzustellende Temperatur richtet sich nach dem Stabilitätsbereich der eingesetzten katalytisch wirksamen Feststoffe.

25

30

Nachteil der früher beschriebenen Verfahren zur destillativen Abtrennung von reinem Silan bei überlagerter Reaktion ist die große Wärmemenge, die bei der Kondensationstemperatur des Silans bei gegebenem Druck, also z.B. bei -50°C bis Lagerührt werden muß. Die Kondensation bei diesen Temperaturen ist, wie bereits erläutert, wirtschaftlich sehr ungünstig. Die bei Betrieb ohne Zwischenkonbereits erläutert, wirtschaftlich sehr ungünstig. Die bei Betrieb ohne Zwischenkondensator abzuführende Wärmemenge liegt in der gleichen Größenordnung wie die den Sumpf der Reaktionskolonne zugeführte Wärmemenge und die für die Wärmemenge und die für die

WO 00/39027 PCT/EP99/09915 - 13 -

wird im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich durch die schnelle Abtrennung entstehender Produkte ein ausreichender Abstand vom jeweiligen chemischen Reaktionsgleichgewicht gewährleistet, so daß die Reaktion stets mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit verläuft. Beispiele für solche Kolonneneinbauten sind Böden, Packungen oder Füllkörper zum Einbringen heterogener Katalysatoren, wie sie z.B. in folgenden Druckschriften beschrieben sind: EP 670 178, EP 461 855, US 5 026 459, US 4 536 373, WO 94/08681, WO 94/08682, WO 94/08679, EP 470 655, WO 97/26971, US 5 308 451, EP 755 706, EP 781 829, EP 428 265, EP 448 884, EP 640 385, EP 631 813, WO 90/02603, WO 97/24174, EP 665 041, EP 458 472, EP 476 938 und deutsches Gebrauchsmuster 298 07 007.3. Es ist aber auch möglich, den festen Katalysator als solchen oder in einer agglomerierten Form auf Destillationsböden auszubreiten. Im Verfahren werden die Verweilzeit, das Katalysatorvolumen und die destillative Trennwirkung im Reaktionsbereich auf die Reaktionskinetik und die Stoffübergangskinetik abgestimmt, wobei das Optimum der Parameter stark von den Randbedingungen wie z.B. vom gewählten Katalysator, dem Stoffsystem und den gewählten Druck- und Temperaturbedingungen abhängt.

5

10

15

20

25

30

Alternativ kann der Katalysator in externe, gegebenenfalls temperierte Reaktoren eingebracht werden, wobei wechselweise die Flüssigphase von der Reaktionskolonne in den Reaktor und von dort zur Stofftrennung wieder zurück in die Kolonne geführt wird. Hierbei wirkt sich jedoch nachteilig aus, daß entstehende Produkte im allgemeinen nicht so schnell nach ihrer Entstehung destillativ abgetrennt werden können, wie dies bei den vorgenannten Böden, Packungen und Füllkörpern der Fall ist. Zur Entkopplung unterschiedlicher Temperaturen innerhalb der Kolonne und in externen Reaktionen ist eine Temperierung der Stoffströme zwischen Kolonne und den Reaktoren möglich.

In Figur 3 ist der destillativ/reaktive Reaktionsbereich 2; 2a aus den Figuren 1 und 2 für die Ausführung mit extern angeordneten Reaktoren dargestellt. Das aus einem destillativen Teil 29 ablaufende flüssige Gemisch gelangt, gegebenenfalls über Wärmerückgewinnung und Temperierung 31 in einen von oben nach unten oder von

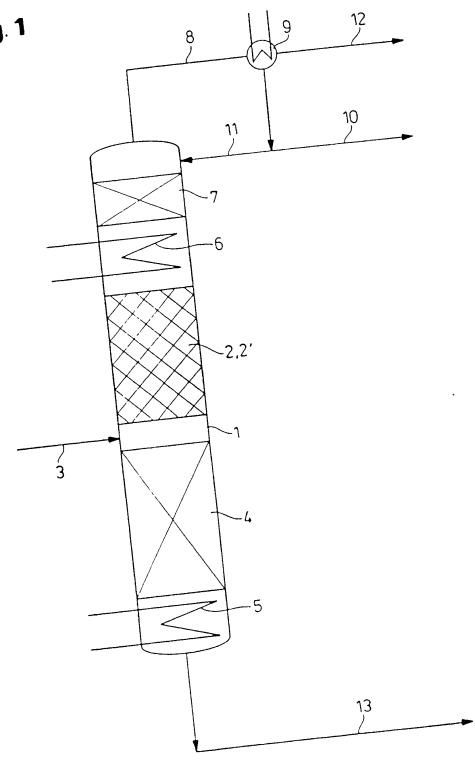
Bezugszeichenliste

		1 10
	Reaktionskolonne	1, 1a
	reaktiv/destillativer Reaktionsbereich	2, 2a 2', 2a'
5	Katalysatorbett	2, 2a 3, 3a
5	SiHCl ₂ - Zuleitung	3, 3a 4, 4a
	destillativer Abtriebsteil	5, 5a
	Sumpfyerdampfer	6, 6a
	Zwischenkondensator	7, 7a
10	Zwischenkondensator	8, 8a
10	Dampfabzug	9, 9a
	Konfkondensator	10, 10a
	SiH ₄ -Produktleitung	11, 11a
	Zweigleitung	12, 12a
15	Inertgasleitung	13, 13a
13	SiCl₄-Abfluß	14
	Trennkolonne	15
	Flüssigkeitspumpe	16
	Druckleitung	17
20	Kompressor	18
	Abzug	19
	Kopfkondensator	20
	SiH ₄ -Produktleitung	21
	Zweigleitung	22
25	Inertgasleitung	23
	Sumpf	24
	Sumpfabzug	25
	Zweigleitung	26
	Rückführung	27
30	Wärmetauscher	28
	Ausschleusung	29
	Destillationsteil	30
	Wärmerückgewinnung	31
	Temperierung/Wärmetauscher	32
35	Reaktor	

20

- Anlage zur Herstellung von Silan SiH₄ in kontinuierlicher Weise durch Dis-6. proportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid SiCl₄ in einer Reaktionskolonne (1, 1a) mit einem reaktiv/destillativen Reaktionsbereich (2, 2a), der ein von Festkörpern aus katalytisch wirkendem Feststoff gebildetes, von den Disproportionierungsprodukten und Trichlorsilan 5 durchströmbares Katalysatorbett (2', 2a') aufweist, mit einem Zulauf (3, 3a) für SiHCl₃ zum Reaktionsbereich, sowie mit einem an der Reaktionskolonne angeschlossenem Kopfkondensator (9, 9a) zur Kondensation von erzeugtem SiH₄-haltigen Produkt und einem Abzug für kondensiertes SiH₄ am Kopfkondensator (10, 10a), und mit einem Abfluß (13, 13a) an der Reaktions-10 kolonne für als Sumpfprodukt anfallendes SiCl₄, zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen reaktiv/ destillativem Reaktionsbereich (2, 2a) und Kopfkondensator (9, 9a) zumindest ein Zwischenkondensator (6, 6a) angeordnet ist, der bei einer Temperatur im Temperaturbereich von -25°C bis 50°C betrieben wird. 15
 - 7. Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Zwischenkondensator (6, 6a) eine Temperatur im Temperaturbereich von -5°C bis 40°C eingestellt ist.
 - 8. Anlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwischenkondensator (6, 6a) oberhalb des Katalysatorbettes (2', 2a') angeordnet ist.
- Anlage nach einem der Ansprüche 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß
 dem Zwischenkondensator (6, 6a) in Strömungsrichtung des vom Zwischenkondensator abströmenden leichter siedenden Produktgemisches ein Verstärkerteil (7, 7a) zur Erhöhung der SiH₄-Konzentration im Produktgemisch
 nachgeschaltet ist.
- 30 10. Anlage nach einem der Ansprüche 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß dem Zwischenkondensator (6a) in Strömungsrichtung des vom Zwischen-

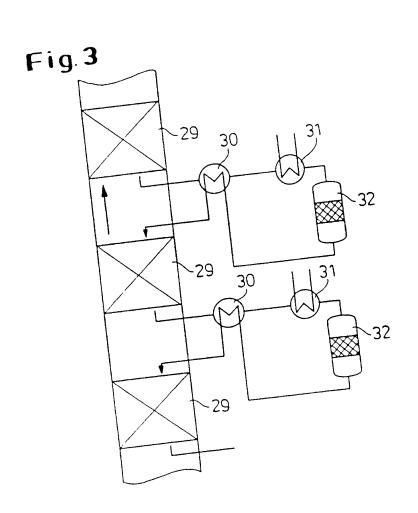
Fig.1



ERSATZBLATT (REGEL 26)

Fig. 2 9,a 8a 18 12a **~**16′ 10a 15 1<u>1</u>a 20 21 16 - 7a -6a ~14 -2a,2a' 23-₂₇ **-25 **1a) 3a 24--26 -4a 281 -5a 13a

ERSATZBLATT (REGEL 26)





onal Application No.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C01B33/04 P0130 (2)	Inte Chal Application No
1PC 7 C01B33/04 B01J8/02	PCT/EP 99/09915
According to International Patent Classification (IPC) or to both nation B. FIELDS SEARCHED Minimum documents	
B. FIELDS SEARCHED	nal classification and upo
Minimum documentation searched (classification	S. Card IPC
Minimum documentation searched (classification system followed by IPC 7 CO18	classification symbols)
1	
cocumentation searched other than minimum documentation to the	
Documentation searched other than minimum documentation to the ex	tent that such documents are included in the fold:
Electronic data base consulted during the intermedia	the reions searched
Electronic data base consulted during the international search (name o	f data base and, where practical economic
	search terms used)
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category • Citation of document with india	
Category • Citation of document, with indication, where appropriate, of	the relevant passages
A PATENT ARSTRACTO	Relevant to claim No.
	100
14 January 1987 (1987-01-14)	1,6
26 August 1986 (1996 KAGAKU	KOGYO KKY
abstract (1986-08-26)	, , ,
A FR 2 261 077	
A FR 2 261 977 A (UNION CARBIDE C 19 September 1975 (1975-09-19) claims 5-20	ORP)
Claims 5-20 (-273 03-19)	1,6
figures 1-3 & DE 25 07 864 A	
cited in the application	
A FP 0 062 065	
A EP 0 063 067 A (RHONE POULENC SP 20 October 1982 (1982-10-20)	FC CUIM)
claims 1,5 (1982-10-20)	1,6
	-,0
	-/
	-/
are leased in the continuation of hour	
pecial categories of cited documents	X Patent family members are listed in annex.
document defining the general state of the art which is not earlier document.	later document
filling date.	or priority date and not in conflict with the application but invention
document which may throw doubte an a "X	document
another	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to document to the claimed invention involve an inventive step when the document to the considered to
other means other means	document of particular relevance at
later than the priority date deima defined filling date but	document invested to tovoke as investion
20 A- 13	The same patent
20 April 2000	Date of mailing of the international search report
and mailing address of the ISA	02/05/2000
NI - 2390 UNA STATE PROPERTY	Authorized officer
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	
SA/210 (second sheet) (July 1992)	Rigondaud, B

Information on patent family members

Inte. onal Application No PCT/EP 99/09915

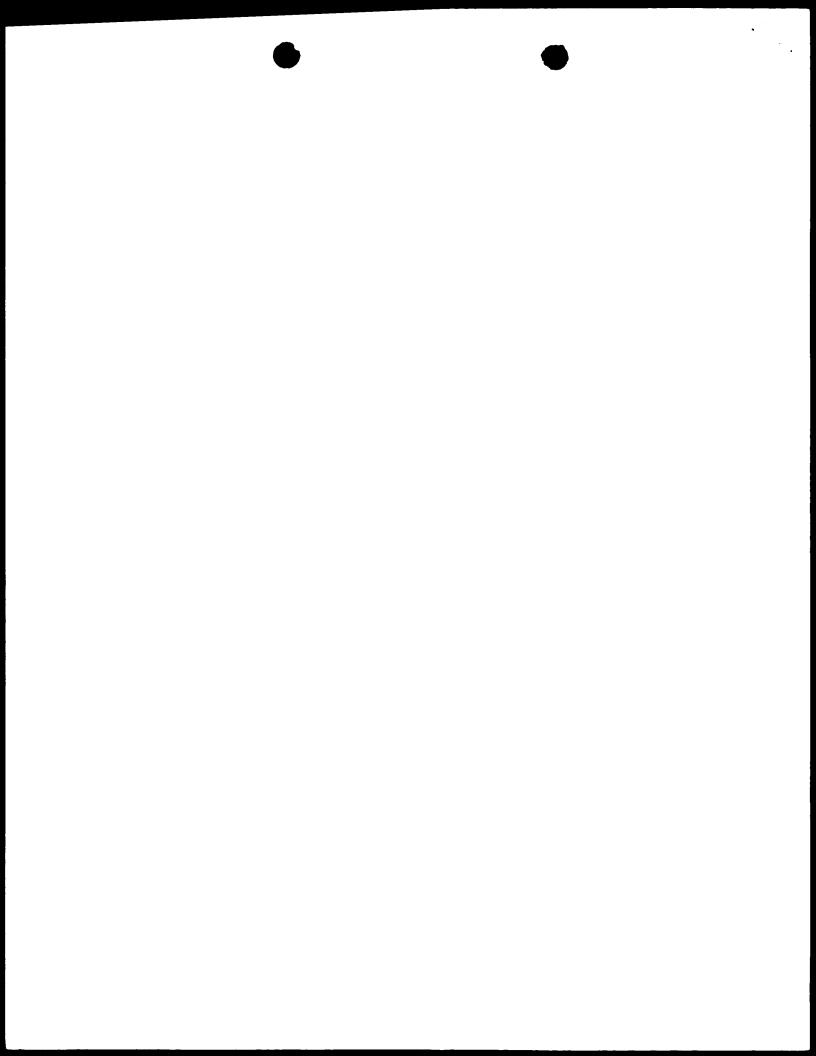
		on on patent family Illoting		1 1/1/21	
	Informati	on on patent family members Publication	Pate	nt family mber(s)	Publication date
Patent document cited in search report		26-08-1986	JP	1779573 C	13-08-1993 12-11-1992
JP 61191513	A	Z0-00-1300	JP	4071008 B 3968199 A	06-07-1976
FR 2261977	A	19-09-1975	US BE DE GB	825872 A 2507864 A 1499137 A 50119798 A	25-08-1975 28-08-1975 25-01-1978 19-09-1975
EP 0063067	Α	20-10-1982	FR AT CA DE JP US	2503125 A 5395 T 1164185 A 3260012 D 57209816 A 4405590 A	08-10-1982 15-12-1983 27-03-1984 29-12-1983 23-12-1982 20-09-1983
US 4613491	A	23-09-1986	KR KR JP JP JP JP JP	8600661 B 8600993 B 1868090 C 60244340 A 1416617 C 61006116 62018483 4701430	26-08-1994 04-12-1985 22-12-1987 11-01-1986 23-04-1987 A 20-10-1987
FR 2118725	5 A	28-07-1972	E	36502/1 776794 988275 E 2162537 B 1377504	A 16-06-1972 A 04-05-1976 A 13-07-1972 A 18-12-1974 23-05-1977 B 20-06-1977 B 13-12-1977
EP 00936	40	09-11-1983		FR 252600 DE 336449 JP 140597 JP 5905461 JP 6201216	9 D 27-10-198 5 C 29-03-198 7 A 27-03-198

A KLASSII IPK 7	C01B33/04 B01J8/02		
Nach der int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	aifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymboli CO1B	⊖)	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	vert diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
•			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr, Anspruch Nr.
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1,6
, ,	vol. 011, no. 013 (C-397),		,
	14. Januar 1987 (1987-01-14) & JP 61 191513 A (DENKI KAGAKU KO	GYO KK).	
	26. August 1986 (1986–08–26)	aro kky,	
	Zusammenfassung		
Α	FR 2 261 977 A (UNION CARBIDE COR	P)	1,6
	19. September 1975 (1975-09-19)		;
	Ansprüche 5-20 Abbildungen 1-3		
	& DE 25 07 864 A		
it.	in der Anmeldung erwähnt 		
Α	EP 0 063 067 A (RHONE POULENC SPE	C CHIM)	1,6
	20. Oktober 1982 (1982-10-20) Ansprüche 1,5		
	Alispi delle 1,3	,	
	_	/	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
A Veröffe	intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondem nu	tworden ist und mit der
aberr "E" ätteres	nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	oder der ihr zugrundeliegenden
L Veröffe	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	chung nicht als neu oder auf
ander	nen zu lässen, öder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	erfinderischer Tätigkeit beruhend betra "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedei	itung; die beanspruchte Erfindung
ausge "O" Veröffe	stührt) antlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	kann nicht als auf erfinderischer Tätigh werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in	einer oder mehreren anderen
eine E	Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen. Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselber	naheliegend ist
	peanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
_	20 Azwil 2000	02/05/2000	
	0. April 2000	02/05/2000	
Name und	Poetanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijawijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fay: (+31-70) 340-3016	Rigondaud, B	

1

onales Aktenzeichen
PCT/EP 99/09915

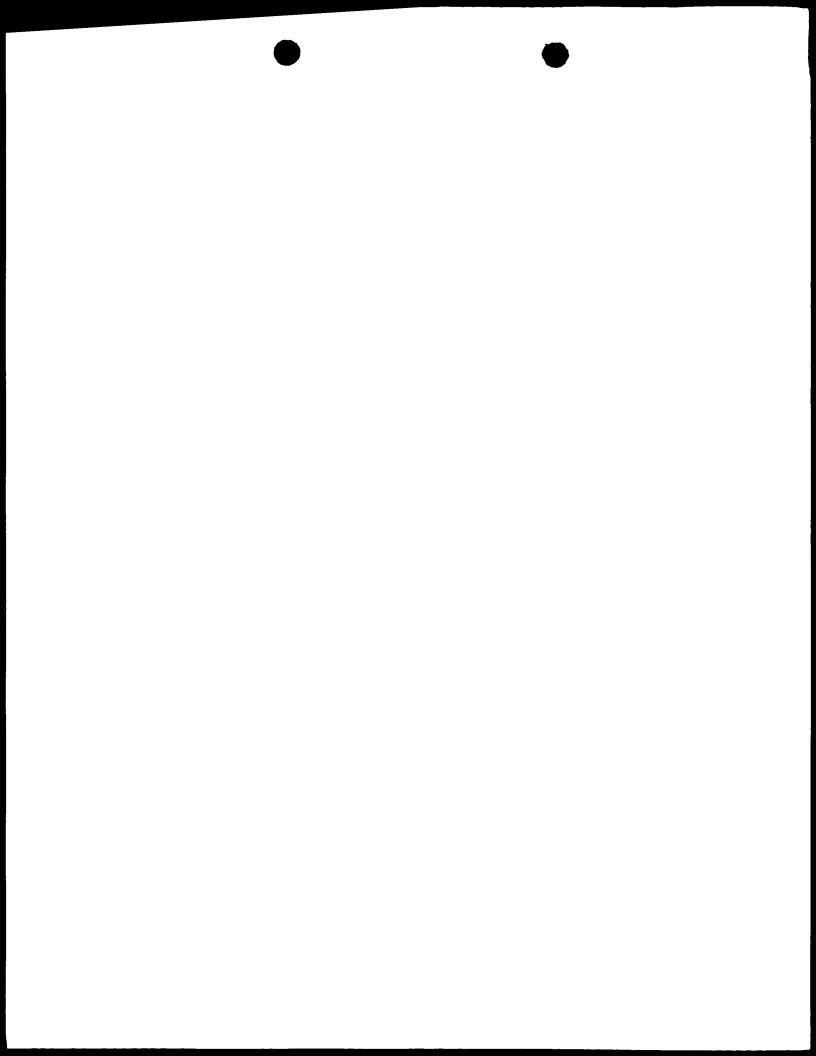
Angeben zu Veröffehillichungen.	, die zur selben Patermannie gom	İ		
1 - Dechembericht	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) de Patentfamilie	er er	Datum der Veröffentlichung
angeführtes Patentdokument	Aeloueumana	47701	72 C	13-08-1993
	26-08-1986		573 C 008 B	12-11-1992
JP 61191513 A	₩ ♥ * *	JP 40710	JUO D	
		2060	199 A	06-07-1976
CP 2261977 A	19-09-1975		872 A	25-08-1975
FR 2261977 A	··	<u> </u>	864 A	28-08-1975
		U-	137 A	25-01-1978
		40	798 A	19-09-1975
		JP 50119		
			3125 A	08-10-1982
EB 0063067 A	20-10-1982	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5395 T	15-12-1983
EP 0063067 A		/\!	4185 A	27-03-1984
		V/\ =	0012 D	29-12-1983
			9816 A	23-12-1982
		V, -	5590 A	20-09-1983
		US 440		
		KR 860	0661 B	29-05-1986
US 4613491	23-09-1986	KR 860	0993 B	26-07-1986
05 4013491	•	JP 186	8090 C	26-08-1994
		JP 6024	14340 A	04-12-1985
		JP 14	16617 C	22-12-1987
		JP 610	06116 A	11-01-1986
		JP 620	18483 B	23-04-1987
		US 47	01430 A	20-10-1987
				09-10-1975
	A 28-07-1972	AU 4	65756 B	14-06-1973
FR 2118725	A 28-07-1972	AU 3	50271 A	16-06-1972
l		DL :	76794 A	04-05-1970
		011	88275 A	13-07-197
		UL -	162537 A	18-12-197
		<u> </u>	377504 A	23-05-197
l			018678 B	20-06-197
			117278 A, 784818 A	13-12-197
		D C	/84818 A 113845 A,	44 44 107
		us 4	113045 A	
			526003 A	04-11-198
	A 09-11-198).) ''' .	364499 D	21-08-198
EP 0093640	Λ	UE ·	1405975 C	27-10-19
		٠.	9054617 A	29-03-19
1		JР 59 JР 6	2012168 B	17-03-19
		. 127 ()		



PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

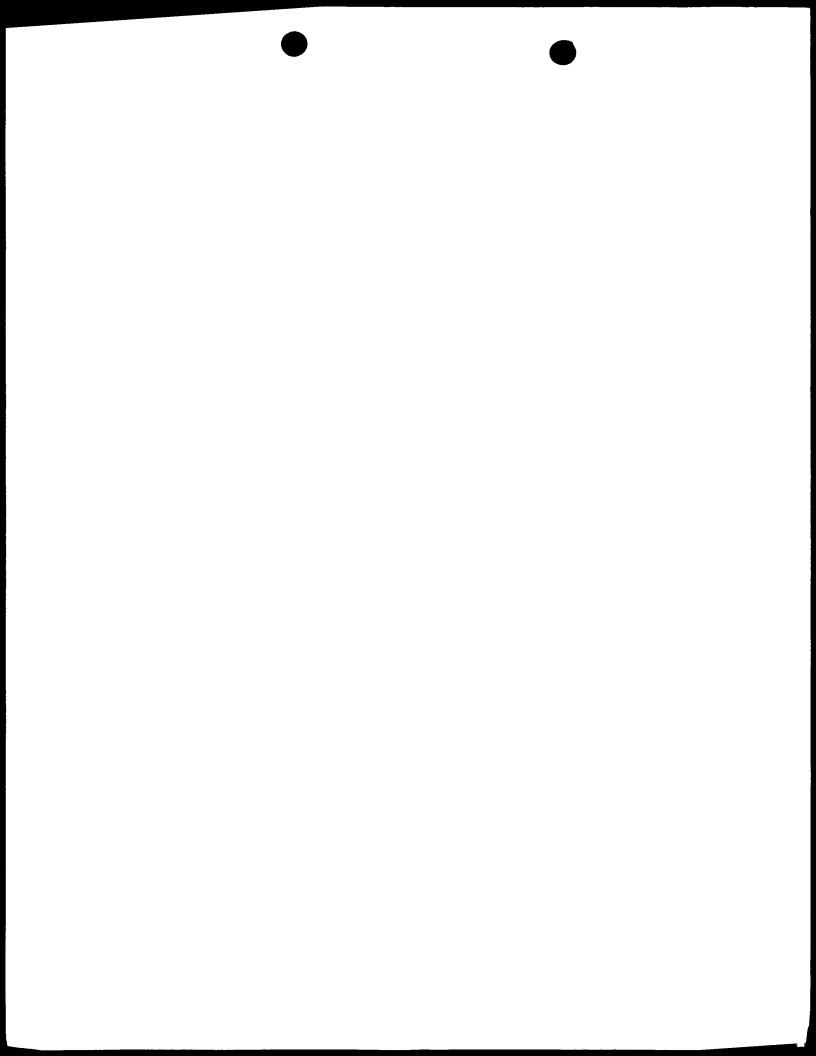
		In 43 und 44 PCT)	r die Übermittlung des internationalen (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit eender Punkt 5
ktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	Recherchenberichts zutreffend, nachsteh	nender Punkt 5 (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
EA33294-WO	VORGEHEN Internationales An		(Frühestes) Phontaissassas
ternationales Aktenzeichen	l - (Mannet/lahr)		24/12/1998
	14/1	2/1999	
PCT/EP 99/09915	1		
Anmelder			
THE STATE OF LICENSET 6	et al.		
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 6			A - molder gemäß
	t Internati	ionalen Recherchenbehör	rde erstellt und wird dem Anmelder gemein
Dieser internationale Recherchenbericht wu Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem	ırde von der internati Internationalen Büro	übermittelt.	rde erstellt und wird dem Anmelder gemäß
- Lashagharicht III	mfaßt insgesamt 3	Blätter.	nnten Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Dieser internationale Recherchenbericht u	jeweils eine Kopie d	er in diesem Bericht geha	
X Darüber hinaus liegt hina			Caracha
Grundlage des Berichts		auf der Grundlage d	er internationalen Anmeldung in der Sprache
Grundlage des Berichts A. Hinsichtlich der Sprache ist die durchgeführt worden, in der sie	internationale Reche	ofern unter diesem Punkt	er internationalen Anmeldung in der Sprache nichts anderes angegeben ist.
Quicingeranis		ar bai der Beho	orde elligereionien -
Die internationale Rech	erche ist auf der Gru Lb)) durchgeführt wo	orden.	d/oder Aminosäuresequenz ist die internationale das
b. Hinsichtlich der in der internationalen A	des Sequenzprotokol	lls durchgetuhrt worden, d	·
Recherche auf der G. Z. Hands in der internationalen A	Anmeldung in Schrifli	cher Form enthalten ist.	orm eingereicht worden ist. n ist.
zusammen mit der inte	ernationalen Anmeldu	ung in compareicht worder	n ist.
hei der Behörde nach	träglich in compatern	Seque	nzprotokoll nicht über den Offenbarans
Die Erklärung, daß da	is nachträglich einge Idung im Anmeldeze	reichte schriftliche Sequel itpunkt hinausgeht, wurde er Form erfaßten Informati	worden ist. nzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der vorgelegt. ionen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
internationalen Anme	ie in computerlesbare	er Form erfaßten Informati	ionen dem schillitisker 3-3
warde 15.5	وخامية و	nicht recherchierbar erw ng (siehe Feld II).	vlesen (siehe Feld I).
2. Bestlmmte Ansprü	che haben sich als	ng (siehe Feld II).	
2. Bestimmte Ansprü-	lichkeit der Emindui	ing (Sierre	
°			
4. Hinsichtlich der Bezelchnung o	ler Erfindung	odaut genehmiat.	
		o folgt festgesetzt:	
wurde der Wortlaut	von der Behörde wie	& loidr ionida	
.4-	eeund		
5. Hinsichtlich der Zusammenfa	solder eingereichte W	ortlaut genehmigt.	enen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Datum der Absendung dieses internationalen
wird der vom Anm	ut nach Regel 38.2b)	in der in Feld III angegeb	enen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Datum der Absendung dieses internationalen
wurde der Worlda Anmelder kann de	er Behörde innerhalb	me vorlegen.	Alab Nir
Anmelder kann de Recherchenberic 6. Folgende Abbildung der Zelc	er Behörde innerralb hts eine Stellungnahr	Zusammenfassung zu ver	röffentlichen: Abb. Nr. keine der Abb.
6. Folgende Abbildung der Zelc	hnungen ist interes		L.J. Roma
wie vom Anmeld	er vorgeschlagen	tung vorgeschlagen hat.	
weil der Anmeld	er selbst keine Abbild	dung vorgeschlagen hat.	
wail diese Abbild	dung die Erfindung be	622CI VELILITATION	





nternationales Aktenzeichen PCT/EP 99/09915

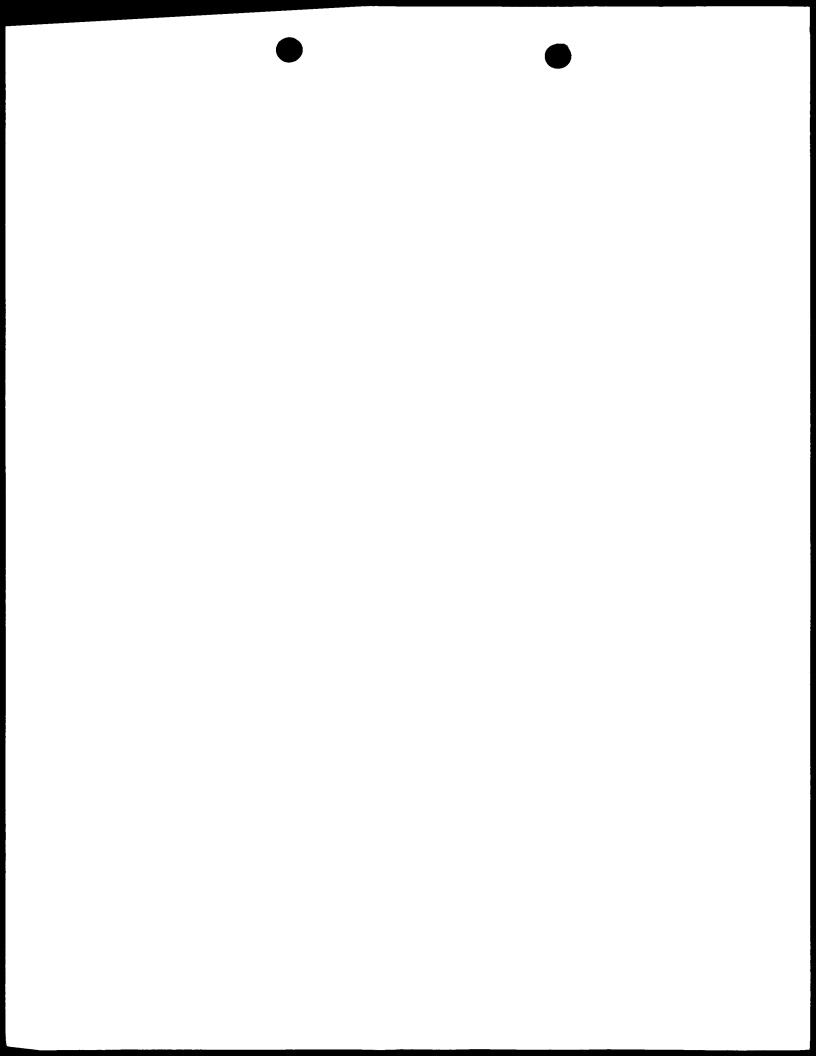
114 1 5 1 11	NATION.	PC1/EP 99/0:	
	ANDEC		
ASSIFIZIERUN	ng des anmeldungsgegenstandes 1833/04 B01J8/02		
7 CO1	(033/04		
		ifikation und der IPK	
	nalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi		
der Internation	TE GEBIETE	'e)	1
nerchierter Mind	destpruiston (Nassiman)		1
			fallen
	er nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	· railOt
herchierte aber	r nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sc		
Character ape		Jame der Datenbank und evtl. verweridete	Suchbegriffe)
	mationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Mattie dei Datempariti	
ährend der inter	manor de la constanta de la co		
			Betr. Anspruch Nr.
. ALS WESEN	NTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN ezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	nabe der in Betracht kommenden Teile	
(ategorie° Be	ezeichnung der Veröffentlichung, soweit errordenich unter eine		1,6
			1,0
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		
	101 NO. 015 (0 14)	NUCAU KK)	
	14. Januar 1907 (DENKT KAGAKU	KUGTU KK),	
1	26 Aliquet 1900 (1909)		
1	Zusammentassung		1,6
	CARRIDE	CORP)	1,0
A	FR 2 261 977 A (UNION CARBIDE)	7)	1
\n \	10 Cantember 13/3 (
1	Anchriiche 5-40		
1	Allsprachen 1-3 Abbildungen 1-3 & DE 25 07 864 A		
1	don Annellaulia el Halli		1,6
	A COHONE POLILENC	SPEC CHIM)	
A	EP 0 063 067 A (RHONE POULENC 20. Oktober 1982 (1982-10-20))	
1"	1 30 OKTODEL 1305 .		
1	Ansprüche 1,5	-/	
1		-1	
1		Siehe Anhang Patentfamil	lie
	Veitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	, tion	nach dem internationalen Anmeldeda
X W	Veitere Veröffentlichungen sind der Fürischungen innehmen	"T" Spätere Veröffentlichung, die r	nach dem internationalen Anmeldeda öffentlicht worden ist und mit der ondem nur zum Verständnis des der ondem nur zum Verständnis des der
0.000000	dere Kategorien von angegebenen Veronermonder.	d Anmeldung nicht kollidiert, sor	ondern nur zum - Brinzins oder der ihr zugrundeliege
		Erfindung Zugruntess Theorie angegeben ist nalen Theorie angegeben ist	erer Bedeutung; die beanspruchte Er
a a be	er flicht die z	"X" Veröffentlichung von Laiscer V	erer Bedeutung; die beanspruchte Ei Veröffentlichung nicht als neu oder a Ihend betrachtet werden
Ani u u Vorë	röffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsansproof	n einer enindenschler varschapt werden "v" Veröffentlichung von besonde	lerer Bedeutung; die bearisprusitet
"L" Ven	heinen zu lassen, oder durch die das veröffentlichung bele deren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung bele	kann nicht als auf erfinderist werden wenn die Veröffentli	icher Tätigkeit berühern dichung mit einer oder mehreren and kategorie in Verbindung gebracht wir Fachmann naheliegend ist
I 50	oli odei die ada -	veroner til enen t	Fachmann naheliegend ist
a∟ "O" Ve	eröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenberahmen bez	- right diese verbilliaans	ed derselben Patentfamilie ist
"P" Ve	eröffentlichung, die vor dem internationaler eröffentlichung, die vor dem internationaler eröffentlicht worden ist	Absendedatum des interna	ationalen Recherchenberichts
- ve	dem beanspruchten Prioritätsdaturi Veronomen dem beanspruchten Prioritätsdaturi Veronomen n des Abschlusses der internationalen Recherche	l l	
Datum		02/05/2000	
1	20. April 2000	Bevollmächtigter Bedienst	teter
	iilon Recherchenbenorde	l	
Name	FIFODAISCHOOL	Rigondaud,	В
1	NL – 2280 HV Rijswijk NL – 2280 HV Rijswijk NL – 24 70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Ki gondaud,	
١	Tel. (+31-70) 340-2016 Fax: (+31-70) 340-3016		



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ternationales Aktenzeichen
PCT/EP 99/09915

		PC1/EP 99/09913	
Fortsetzun	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht ko	ommenden Teile Betr. Anspruch Nr	r.
ategorie° [Bezeichnung der Veröffentlichung, sonn		
	US 4 613 491 A (JUNG IL N ET AL) 23. September 1986 (1986-09-23)		
4	FR 2 118 725 A (UNION CARBIDE CORP)		
4	EP 0 093 640 A (RHONE POULENC SPEC CHIM) 9. November 1983 (1983-11-09)		
1			

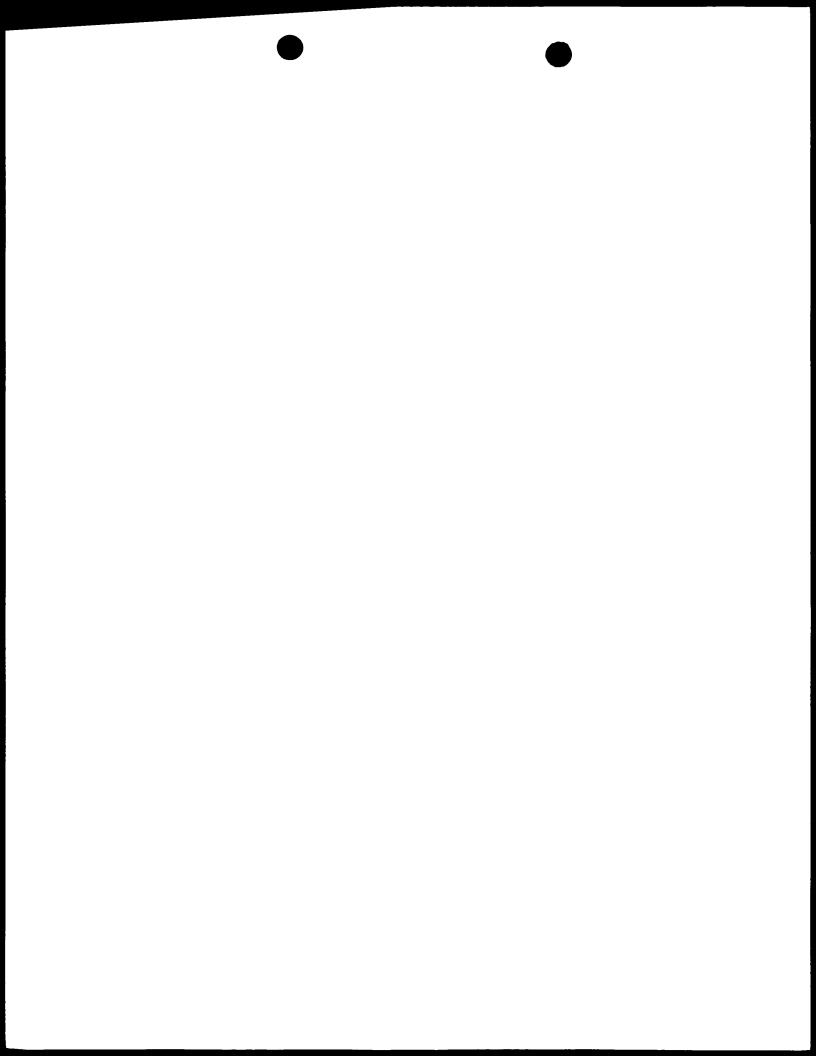


INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

ternational Application No PCT/EP 99/09915

0.111.2	on on patent family members			Publication
	Publication	me	ent family ember(s)	date
	26-08-1986	JP	1779573 C	13-08-1993 12-11-1992
A	20-00-1300	JP 	4071008 B	 υ6-07-1976
A	19-09-1975	US BE	825872 A	25-08-1975 28-08-1975
		DE GB	1499137 A	25-01-1978 19-09-1975
		JP	50119798 A	
	 20-10-1982	FR	2503125 A 5395 T	08-10-1982 15-12-1983
Λ	_	CA	1164185 A	27-03-1984 29-12-1983
			57209816 A	23-12-1982 20-09-1983
		US		29-05-1986
	23-09-1986	KR	8600661 B 8600993 B	26-07-1986
Λ.		JP	1868090 C	26-08-1994 04-12-1985
			1416617 C	22-12-1987 11-01-1986
		JP JP	62018483 B	23-04-1987 20-10-1987
		US	4701430 A	
	28-07-1972			09-10-1975 14-06-1973
А	20 0		776794 A	16-06-1972 04-05-1976
			2162537 A	13-07-1972
		GI	377504 A	23-05-1977
			i 7117278 /	A,B, 20 00 1972
			4112045	40 00 1079
		 F	R 2526003	A 04-11-198 D 21-08-198
о А	09-11-1983	ſ	DE 3364499	D 27-10-198
			JP 59054617	A 29-03 130
	A	A 19-09-1975 A 20-10-1982 A 23-09-1986	A 19-09-1975 US BE DE GB JP A 20-10-1982 FR AT CA DE JP US A 23-09-1986 KR KR JP	A 19-09-1975 US 3968199 A BE 825872 A DE 2507864 A GB 1499137 A JP 50119798 A A 20-10-1982 FR 2503125 A AT 5395 T CA 1164185 A DE 3260012 D JP 57209816 A US 4405590 A A 23-09-1986 KR 8600993 B JP 1868090 C JP 60244340 A JP 1416617 C JP 61006116 A JP 62018483 B US 4701430 A A 28-07-1972 AU 465756 B AU 3650271 A BE 776794 A CA 988275 A DE 2162537 A GB 1377504 A JP 52018678 B NL 7117278 B NL 7117278 B T84818 B US 4113845



International application No.

PCT/EP99/09915

	THE TOTAL DV EVAMINA	ATION REPORT	PCT/EP99/09915
INTERNATIONAL PRE	LIMINAKY EXAMINA		
nis report has been drawn on the international ap the description.	ne basis of (Replacement sheet his report as "originally filed" plication as originally filed. pages	as which have been furnished to the and are not annexed to the report of the association and are not annexed. as originally filed. filed with the demand. filed with the letter of filed with the letter of	e receiving Office in response to an invitation ort since they do not contain amendments.):
the claims.	Nos Nos	, filed with the demand,	le 19.
the drawings, the drawings,	sheets/figsheets/figsheets/fig	filed with the letter of filed with the letter of	f
the description the claims. the drawings This report has been to go beyond the description the description.	Nos Nos sheets/fig en established as if (some of disclosure as filed, as indicat		n made, since they have been considered Rule 70.2(c)).
4. Additional observations.	, if necessary:		

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

international application No. PCT/EP 99/09915

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

V.	Reasoned statement under security citations and explanations supporting	such statement		
1.	Statement		3, 4, 5, 7, 11, 12	YES -
	Novelty (N)	Claims	1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14	NO
	Novelly (1-7)	Claims	1, 2,	YES
	(15)	Claims	3, 4, 5, 7, 11, 12	NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-14	YES
	Industrial applicability (IA)	Claims		NO
	Industrial application	Claims		

Citations and explanations 2.

1) Reference is made to the following document:

D1: FR-A-2 118 725.

2) Novelty PCT Article 33(1) and (2)

- Document D1 discloses a continuous process (page 3, lines 10-12) for producing SiH_4 through catalytic 2.1. disproportionation of $HSiCl_3$ (page 2, lines 5-8). The catalyst is used in the form of a fixed bed (page 2, lines 27-31). The resulting product mix is separated by condensation at a temperature below -10°C from the SiH_4 , which is volatile at this temperature, and thereafter condensed in a condensation trap (page 11, line 37 to page 12, line 5, and Example 6) at a pressure of 1.8 bar (Example 1). During the process, trichlorosilane obtained from the product mix is reintroduced into the reaction column (page 10, line 20). Therefore, the requirements for novelty as laid out in PCT Article 33(1) and (2) are not fulfilled by the subject matter of Claims 1 and 2.
 - The arrangement disclosed in D1 contains a fixed bed

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EF 99/09915

with an immobilized catalyst and a device for condensing byproducts (at $T=-10\,^{\circ}\text{C}$) and an end condensing byproducts (at $T=-10\,^{\circ}\text{C}$) and an end product (see 2.1). Figure 3 of D1 shows that the arrangement disclosed therein consists of an outlet arrangement disclosed therein consists of an outlet for SiH₄ and an outflow for SiCl₄. Therefore, the subject matter of Claim 6 can not be recognized as novel.

- 2.3. In D1, both the distillation column for separating SiH_4 from chlorosilanes and the device for condensing SiH_4 are arranged above the catalyst bed (Figure 3). Accordingly, the subject matter of (Figure 8 and 10 can not be recognized as novel.
 - 2.4. A purification device such as the "épurateur" (35) in Figure 3 of D1 can be regarded as a reinforcing agent for the separation of SiH₄ from other gaseous mixture parts. Therefore, the subject matter of claim 9 can not be regarded as novel.
 - 2.5. The separation column of D1 is operated at an increased pressure of 1.8 bar. It is implicit that the gaseous product is congensed. Therefore, the the gaseous product is congensed and not be regarded as subject matter of Claim 13 can not be regarded as novel.
 - 2.6. In Figure 3 of Dl, is it recognizable that branch piping (30) with H_2SiCl_2 from the separation column (29) is recirculated back to the reactor column. Therefore, the subject matter of Claim 14 is not regarded as novel.
 - 2.7. A process suited for producing silane with the technical process features as claimed in Claims 3-5 technical process features for producing silane with and an arrangement suited for producing silane with

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 99/09915

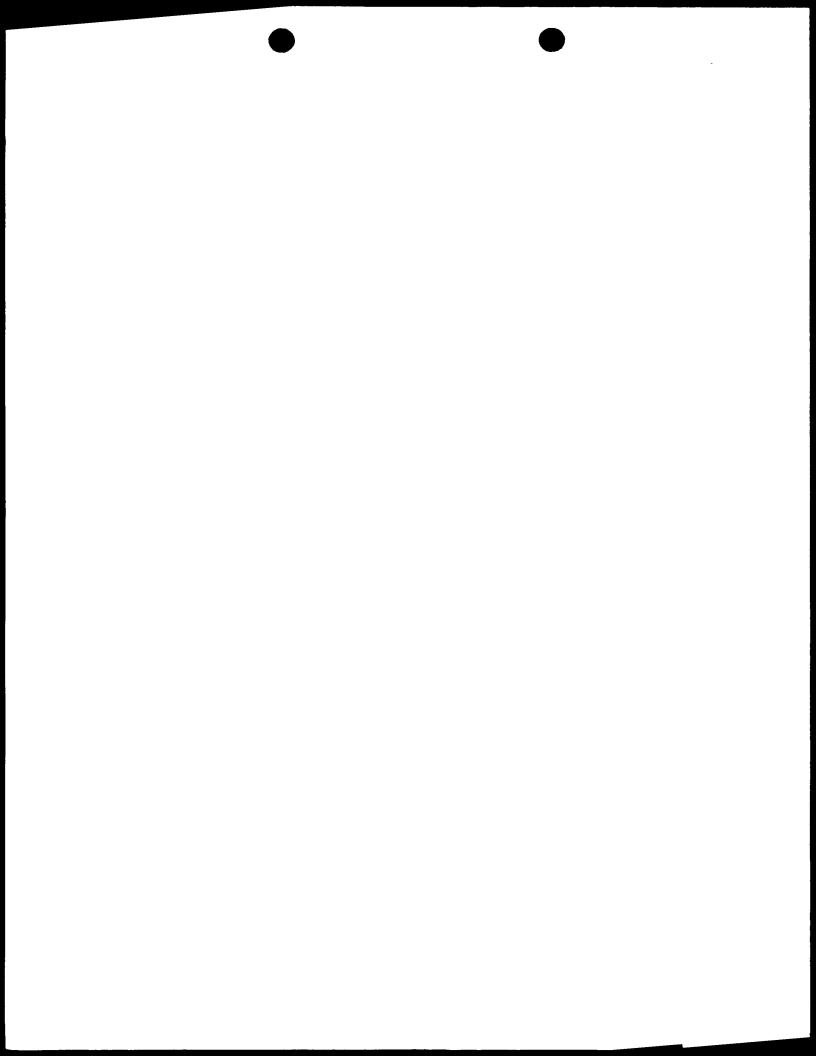
the technical process features as claimed in Claims 7, 11, and 12 is not known from the prior art. Therefore, the subject matter of Claims 3, 4, 5, 7, 11, and 12 is regarded as novel.

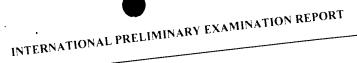
3) Inventive step (PCT Article 33(1) and (3))

3.1. The technical problem addressed by the present application is regarded as providing a process and an arrangement for producing silane. The solution an arrangement for producing silane. The solution provided by the present application consists in a provided by the present application consists in a continuous process for solid catalyzed continuous process for solid catalyzed disproportionation of trichlorosilane to silane and disproportionation of trichlorosilane to silane a mixture of chlorosilane. The desired silane product is separated by means of condensation from the gaseous product mixture.

Document D1 is regarded as the closest prior art.

3.2. In D1, the condensation of the resulting product mixture is conducted at $-10\,^{\circ}\text{C}$, whereas in the present application the preferred temperature range claimed therefor in Claim 3 is -5 - 40° C without specifying special pressure ratios. The boiling point is -111.9°C for SiH4, -30.4°C for H3SiCl, and above $+8\,^{\circ}\text{C}$ for all higher chloresilanes. Therefore, it is not evident that a special technical effect, such as a special separation effect, can be observed for the claimed temperature range. The feature of the temperature range is only one of several obvious possibilities from which a person skilled in the art would choose in order to solve the problem of interest, without thereby being inventive. Therefore, the subject matter of Claims 3 and 7 does not involve an inventive step.





International application No.
PCT/EP 99/09915

- 3.3. Document D1 discloses both conducting the process under increased pressure and recirculating chlorosilane (see 2.1). Therefore, the subject chlorosilane (see 2.1). Therefore, the subject and matter of Claims 4 and 5 does not involve an inventive step.
 - 3.4. The arrangement components reinforcing agent device, condenser and separation column are arranged in an order obvious to a person skilled in the art that order obvious to a person of the arrangement of moreover is only a variation of the arrangement of these three components in D1. Therefore, the subject these three components in D1 and 12 can not be regarded as inventive.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ternational application No. PCT/EP 99/09915

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made: VIII. Certain observations on the international application supported by the description, are made:

- In independent Claims 1 and 6, the expressions "intermediately condensed" and "intermediate condenser" are vague, lack clarity, and leave the a. reader uncertain about the meaning of the technical features concerned. It can also not be found in the corresponding description which technical effect is achieved through said intermediate condensation (whether, for example, all product parts are condensed with the exception of SiH; and inert gas or whether only relatively not easily volatilized parts of the product mixture are retained, for example; see description pages 2, lines 25-27, and page 4, paragraph 3, for example). Accordingly, the definition of the subject matter of these claims lacks clarity (PCT Article 6).
 - In Claims 9, 11, and 12, the expression "reinforcing agent part" is vague, lacks clarity and leaves the reader uncertain about the meaning of the technical b. feature concerned. It can also not be found in the corresponding description which technical effect is achieved through said reinforcing agent part in the claimed process. Accordingly, the definition of the subject matter of this claim lacks clarity (PCT Article 6).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ernational application No. PCT/EP 99/09915

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- In the description, reference sign "7" is specified as "reinforcing agent part" (page 8, line 27, for a. example) yet in the table on page 15 as an intermediate condenser.
 - The reference to Claim 15 in Claim 14 is clearly b. incorrect.

VERTRAG ÜBEN DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

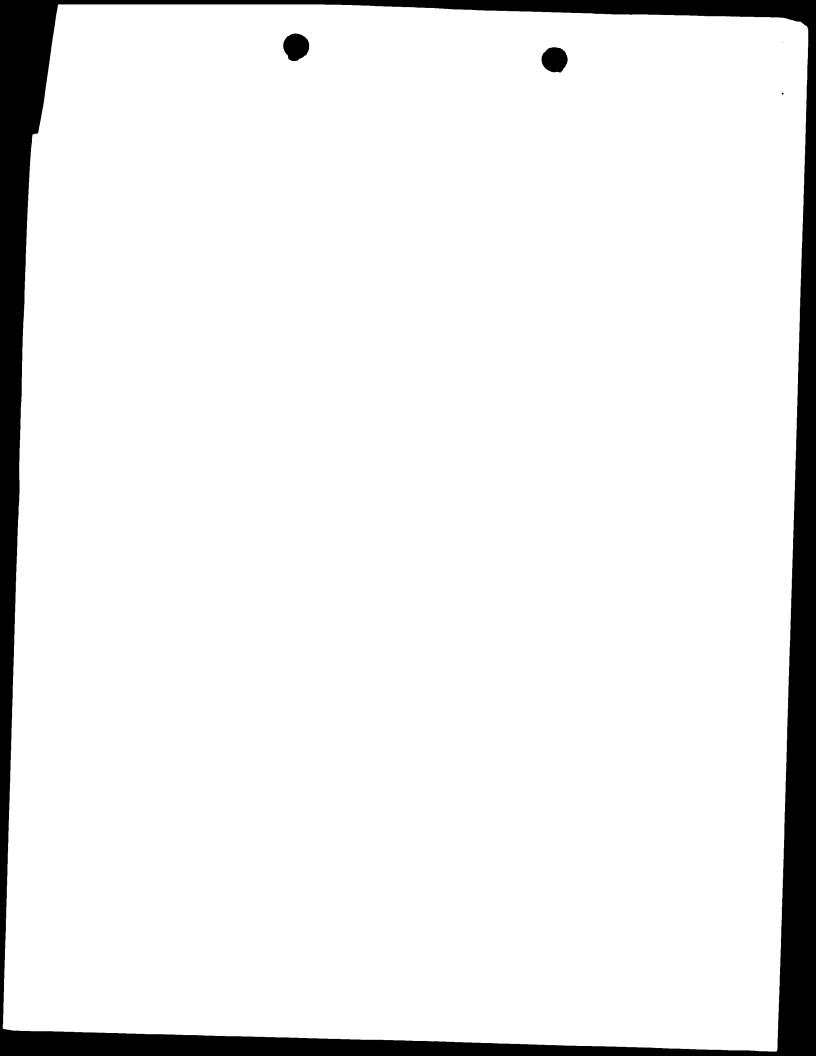
PCT

PCT MIPO

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

	(Artikel 36 und Reg		
tenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN		ilung über die Übersendung des internationalen I Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
EA33294-WO			T
ternationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(7	. mgr. er or rav dat II j	24/12/1998
PCT/FP99/09915			
ternationale Patentklassifikation (IPK) oder 01B33/04	i nationale Massilikation und IP K		
nmelder			
DAVER AKTIENGESELLSCHAFT	et al.		
Dieser internationale vorläufige Pr Behörde erstellt und wird dem Ani	rüfungsbericht wurde von der n melder gemäß Artikel 36 übern		tionalen vorläufigen Prüfung beauftragten
Dieser BERICHT umfaßt insgesal	mt 7 Blätter einschließlich dies	es Deckblatts	3 .
□	nt ANLAGEN bei; dabei handel	t es sich um B	Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen de liegen, und/oder Blätter mit vor dieser nnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT
Behörde vorgenommenen bi	enemgangen (element)	= +1	
Diese Anlagen umfassen insges	amt Blätter.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
IV 🔲 Mangelnde Einheitli	chts nes Gutachtens über Neuheit, e	ara day Nouk	Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit heit, der erfinderischen Tätigkeit und der Stützung dieser Feststellung
gewerblichen Anwe	endbarkeit; Officiagen and Em	-	
N Rostimmte Mängel	der internationalen Anmeldung	1	
VII ⊠ Bestimmte Manger VIII ⊠ Bestimmte Bemerk	kungen zur internationalen Anm	neldung	
VIII 2 DOSMINING DOMAIN			
Datum der Einreichung des Antrags	2	atum der Fertig	gstellung dieses Berichts
06/06/2000		30.03.2001	
Name und Postanschrift der mit der inte Prüfung beauftragten Behörde:	ernationalen vorläufigen	3evollmächtigtei	er Bediensteter
Europäisches Patentamt		Krafka, B	
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 5 Fax: +49 89 2399 - 4465	523656 epmu d	Tel. Nr. +49 89	2399 8143



PCT/EP 9 9 / 0 9 9 1 5

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY

PRIORITY

DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 0 1 FEB 2000

WIPO PCT

09/868^{77 (}

Bescheinigung

6 30/ 3915

Die Bayer Aktiengesellschaft in Leverkusen/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Verfahren und Anlage zur Herstellung von Silan"

am 24. Dezember 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig das Symbol C 01 B 33/04 der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 22. Oktober 1999

Deutsches Patent- und Markenamt

Der/Prasident

uh Auftrag

Aktenzeichen: 198 60 146.8

Nietiedt

Verfahren und Anlage zur Herstellung von Silan

Die vorliegende Erfindung betrifft ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Silan SiH₄ durch katalytisches Disproportionieren von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid SiCl₄. Gegenstand der Erfindung ist auch eine Anlage zur Durchführung des Verfahrens.

SiH₄ ist ein hervorragend geeignetes Ausgangsmaterial, aus dem, gegebenenfalls nach weiterer Reinigung, durch thermische Zersetzung sehr reines Silicium in Halbleiterqualität abgeschieden werden kann. Der Bedarf an Reinst-Silicium wächst stark und damit der Bedarf an reinem Silan, dessen hervorragende Eignung zur Reinst-Silicium-Erzeugung immer mehr erkannt und genutzt wird.

Unter den in der Literatur beschriebenen Verfahren zur Herstellung von Silan ist die Erzeugung aus Trichlorsilan durch Disproportionierung wirtschaftlich vorteilhaft. Bekannt ist es, daß Amine, speziell tertiäre Amine und ihre Hydrochloride und quartäre Ammoniumchloride, sowohl in flüssiger (DE 3 500 318) als auch in fester Form, z.B. an feste Träger gebunden, als Katalysatoren die Disproportionierung des Trichlorsilans in wirtschaftlich vorteilhafter Weise beschleunigen. An feste Träger gebundene Amine (US 4 701 430, US 5 026 533, DE 3 500 318, DE 3 311 650) werden vorzugsweise deshalb eingesetzt, weil damit der Eintrag von verunreinigenden Aminen in die reagierende gasförmig-flüssige Silan-Chlorsilan-Phase vermieden werden kann.

Die in einigen anderen beschriebenen Verfahren gewählten flüssigen Katalysatoren haben den Nachteil, daß sie über die Zeit langsam aus dem Reaktionsteil ausgetragen werden, da sie niemals vollständig von den Reaktionsprodukten abgetrennt werden können. Die mitgeschleppten Katalysatormengen führen in nachfolgenden Verfahrensschritten oder in einem Kreislaufsystem auch in vorgeschalteten Verfahrensschritten zu Problemen, weil sie sich an bestimmten Stellen des Systems sammeln

20

15

5

10

25

30

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09915

I. Grundlage	des	Berichts
--------------	-----	----------

1.	Grundlage des Berich Dieser Bericht wurde en Artikel 14 hin vorgelegt nicht beigefügt, weil sie Beschreibung, Seiten 1-15	stellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm keine Änderungen enthalten.): ursprüngliche Fassung
Patentansprüche, Nr.:		. .
	1-14	ursprüngliche Fassung
	Zeichnungen, Blätte	er:
	1/3-3/3	ursprüngliche Fassung
	die internationale Alunter diesem Punkt Die Bestandteile stateingereicht; dabei h die Sprache de Regel 23.1(b)) die Veröffentlich die Sprache dist (nach Regel 3. Hinsichtlich der in internationale vorl	er Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (was chungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). Den der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden der 55.2 und/oder 55.3). Der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
	☐ in der interna☐ zusammen m☐ bei der Behö☐ bei der Behö☐ Die Erklärun Offenbarung	tionalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. nit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. rde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. orde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. orde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. orde nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den g, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den gsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. orde, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen otokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

PCT/EP99/09915 Internationales Aktenzeichen

RÜFUNGSBERICHT					
Ansp Zeic 5. Dies ang eing	hreibung, orüche, hnungen, ser Bericht ist of egebenen Grün gereichten Fass uf Ersatzblätter, izufügen).	Seiten: Nr.: Blatt: Inne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den inne Berücksichtigung (von einigen) der Öffenbarungsgehalt in der ursprünglich den nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ung hinausgehen (Regel 70.2(c)). Indie solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht			

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

3,4,5,7,11,12 Ansprüche 1,2,6,8,9,10,13,14 Nein: Ansprüche Neuheit (N)

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Nein: Ansprüche

Ansprüche 3,4,5,7,11,12

1-14 Ansprüche Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Nein: Ansprüche

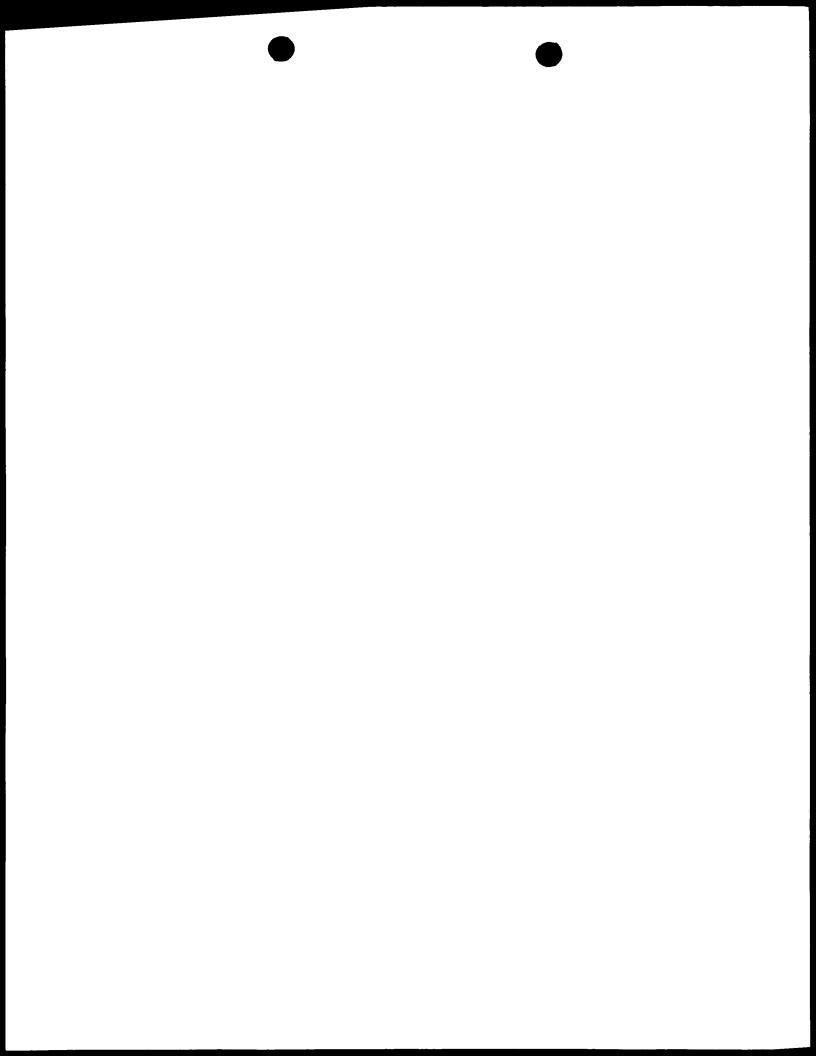
2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt



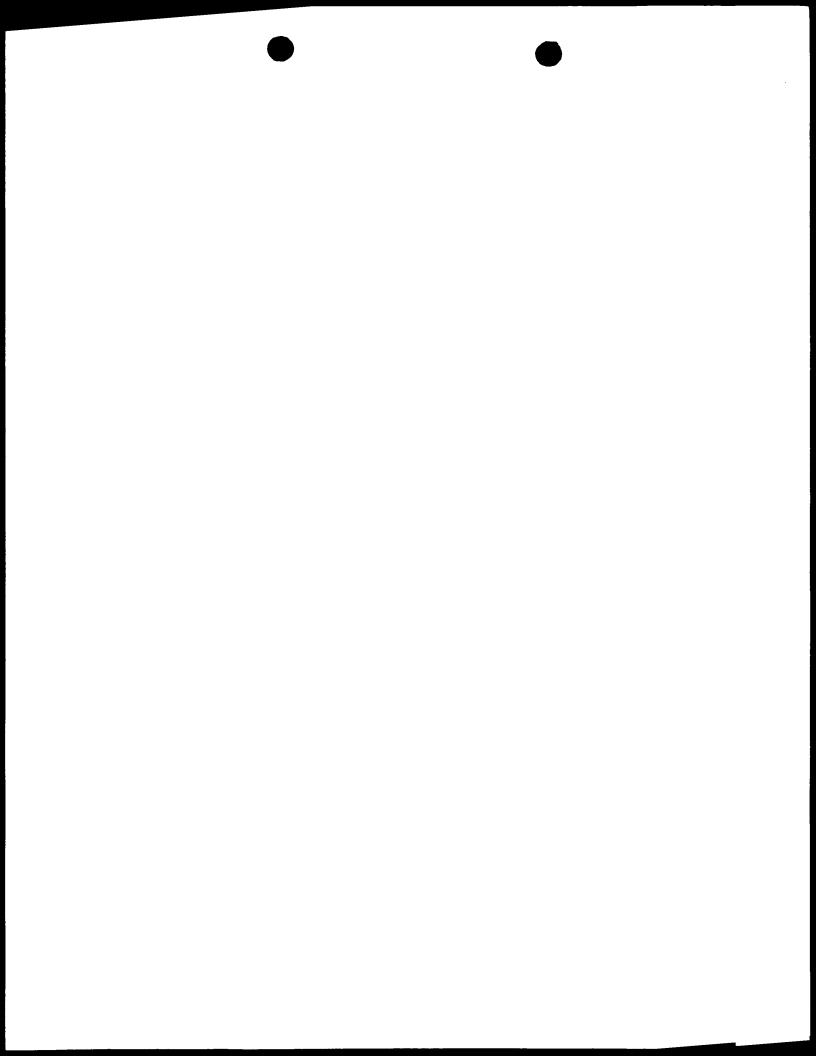
Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1) Es wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D1: FR-A-2 118 725

2) Neuheit - Artikel 33 (1) und (2) PCT

- 2.1. D1 offenbart ein kontinuierliches Verfahren (Seite 3 Zeilen 10-12) zur Herstellung von SiH₄ durch katalytische Disproportionierung von HSiCl₃ (Seite 2 Zeilen 5-8). Der Katalysator wird in Form eines Feststoffbettes eingesetzt (Seite 2 Zeilen 27-31). Das entstehende Produktgemisch wird bei einer Temperatur unterhalb von -10°C durch Kondensation von dem bei dieser Temperatur flüchtigen SiH₄ abgetrennt und dieses anschließend in einer Kühlfalle kondensiert (Seite 11 Zeile 37 - Seite 12 Zeile 5 und Beispiel 6), der Druck hierbei beträgt 1,8 bar (Beispiel 1). Im Laufe des Verfahrens wird mit dem Produktgemisch erhaltenes Trichlorsilan in die Reaktionskolonne rückgeführt (Seite 10 Zeilen 20). Daher sind für den Gegenstand von Anspruch 1 und 2 die Voraussetzungen für Neuheit entsprechend Artikel 33 (1) und (2) PCT nicht erfüllt.
 - 2.2. Die in D1 offenbarte Anlage enthält ein Festbett mit immobilisiertem Katalysator und eine Vorrichtung zur Kondensation von Nebenprodukten (bei $T = -10^{\circ}C$) und Endprodukt (s. 2.1). In Abbildung 3 von D1 ist dargestellt, daß die dort offenbarte Anlage einen Abzug für SiH_4 und einen Abfluß für $SiCl_4$ enthält. Daher kann für den Gegenstand von Anspruch 6 Neuheit nicht anerkannt werden.
 - 2.3. Sowohl die Destillationskolonne zum Abtrennen von SiH₄ von Chlorsilanen als auch die Vorrichtung zum Kondensieren von Si H_4 sind in D1 oberhalb des Katalysatorbettes angeordnet (Abbildung 3). Damit kann für den Gegenstand von Ansprüchen 8 und 10 Neuheit nicht anerkannt werden.
 - 2.4. Eine Reinigungsvorrichtung wie der "épurateur" (35) in Abbildung 3 von D1 kann



als Verstärker der Trennung von SiH₄ von anderen gasförmigen Gemischanteilen angesehen werden. Damit kann für den Gegenstand von Anspruch 9 Neuheit nicht anerkannt werden.

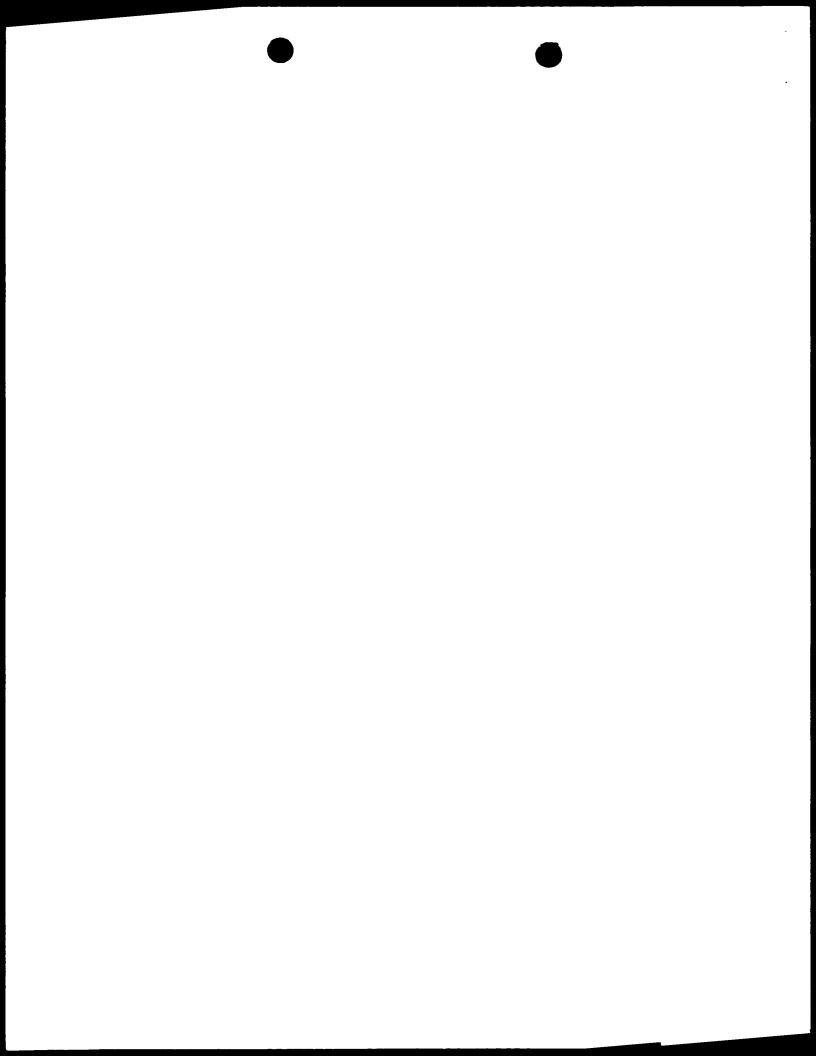
- 2.5. Die Trennkolonne von D1 wird bei einem erhöhten Druck von 1,8 bar betrieben. Es ist implizit, daß das gasförmige Produkt komprimiert wird. Der Gegenstand von Anspruch 13 wird daher nicht als neu betrachtet.
- 2.6. In Abbildung 3 von D1 kann man erkennen, daß von der Trennkolonne (29) eine Zweigleitung (30) mit H₂SiCl₂ wieder in die Reaktorkolonne rückgeführt wird. Der Gegenstand von Anspruch 14 wird daher nicht als neu betrachtet.
- 2.7. Ein Verfahren geeignet zur Herstellung von Silan mit den technischen Verfahrensmerkmalen wie beansprucht in den Ansprüchen 3-5 und eine Anlage geeignet zur Herstellung von Silan mit den technischen Verfahrensmerkmalen wie beansprucht in den Ansprüchen 7, 11 und 12 ist aus dem Stand der Technik nicht bekannt. Der Gegenstand der Ansprüche 3, 4, 5, 7, 11 und 12 wird daher als neu betrachtet.

3) Erfinderische Tätigkeit - Artikel 33 (1) und (3) PCT

3.1. Das der vorliegenden Anmeldung zugrundeliegende technische Problem wird als das zur Verfügung stellen eines Verfahrens und einer Anlage zur Herstellung von Silan betrachtet. Die in der vorliegenden Anmeldung dargelegte Lösung besteht in einem kontinuierlichen Verfahren zur feststoffkatalysierten Disproportionierung von Trichlorsilan zu Silan und einem Gemisch von Chlorsilanen. Das gewünschte Produkt Silan wird durch Kondensation aus dem gasförmigen Produktgemisch abgetrennt.

Als nächstliegendes Dokument wird D1 betrachtet.

3.2. Die Kondensation des entstehenden Produktgemisches wird in D1 bei -10°C durchgeführt, während in der vorliegenden Anmeldung hierfür in Anspruch 3 als bevorzugter Temperaturbereich -5 - 40°C beansprucht wird, ohne daß besondere Druckverhältnisse gegeben sind. Die Siedepunkte liegen für SiH₄ bei -111,9°C, für H₃SiCl bei -30,4°C und für alle höheren Chlorsilane über +8°C. Es ist daher nicht erkenntlich, daß für den beanspruchten Temperaturbereich ein besonderer tech-



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

nischer Effekt, z.B. eine besondere Trennwirkung, zu beobachten wäre. Bei dem Merkmal des Temperaturbereiches scheint es sich daher nur um eine Auswahl aus mehreren naheliegenden Möglichkeiten zu handeln, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Der Gegenstand der Ansprüche 3 und 7 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

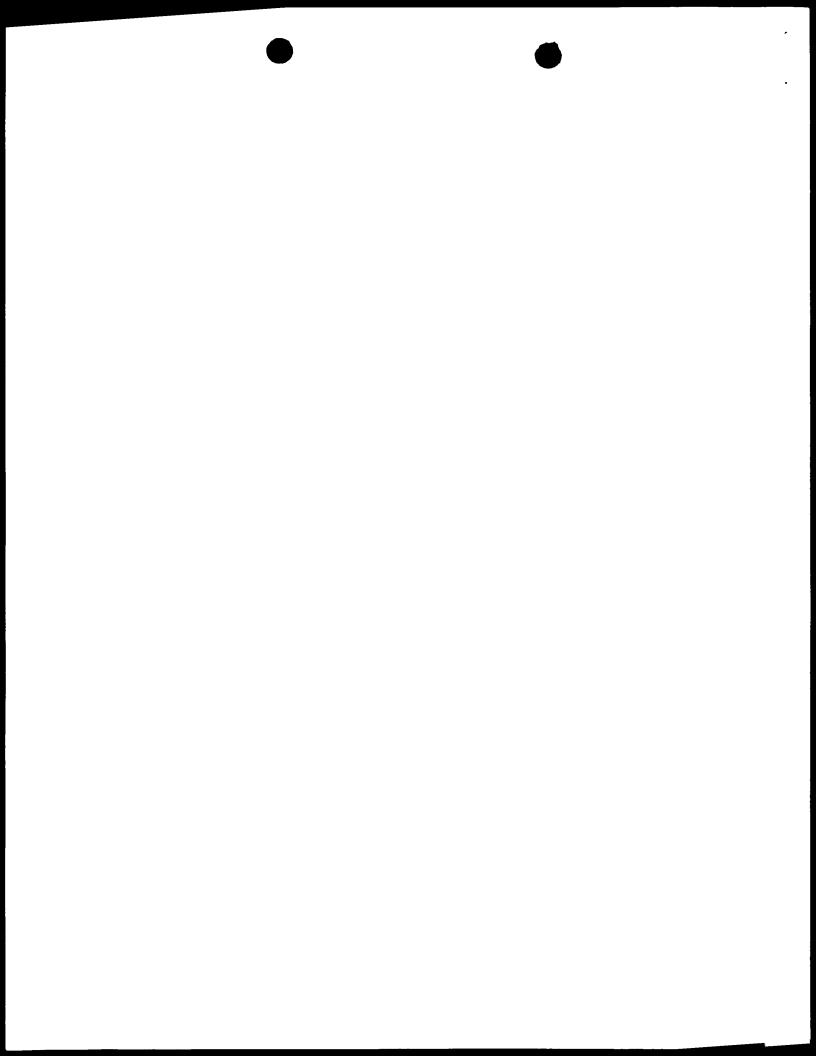
- 3.3. In D1 sind sowohl die Durchführung des genannten Verfahrens bei erhöhtem Druck als auch die Rückführung von Chlorsilan offenbart (s. 2.1). Der Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- 3.4. Die Anlagenkomponenten Verstärkereinrichtung, Kondensator und Trennkolonne werden in einer für einen Fachmann naheliegenden Reihenfolge angeordnet, die zudem lediglich eine Variation der Anordnung dieser drei Komponenten in D1 darstellt. Für den Gegenstand der Ansprüche 11 und 12 kann daher keine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden.

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung Zu Punkt VII

- Das Bezugszeichen "7" wird in der Beschreibung als "Verstärkerteil" (z.B. Seite 8 Zeile 27), in der Tabelle auf Seite 15 jedoch als Zwischenkondensator aufgeführt. a.
- In Anspruch 14 ist der Bezug auf Anspruch 15 offensichtlich falsch. b.

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung Zu Punkt VIII

Die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 6 benutzten Ausdrücke "zwischenkondensiert" bzw. "Zwischenkondensator" sind vage und unklar und lassen den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungea. wissen. Auch aus der zugehörigen Beschreibung ist nicht zu entnehmen, welcher technische Effekt bei der genannten Zwischenkondensation bewirkt wird (ob z.B. alle Produktanteile mit Ausnahme von SiH_4 und Inertgas kondensiert werden, oder ob z.B. lediglich relativ schwerflüchtige Teile des Produktgemisches zurück-



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09915

gehalten werden; vgl. Beschreibung beispielsweise Seite 2 Zeilen 25-27 und Seite 4 Abschnitt 3). Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

b. Der in den Ansprüchen 9, 11 und 12 benutzte Ausdruck "Verstärkerteil" ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Auch aus der zugehörigen Beschreibung ist nicht zu entnehmen, welchen technischen Effekt das genannte Verstärkerteil bei dem beanspruchten Prozeß bewirkt. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche nicht klar ist (Artikel 6 PCT).



WO 00/39027 - 3 -

(1) apparativ einstufig ist, also Silan und Siliciumtetrachlorid als gewünschte, angereicherte Produkte von verschiedenen Stellen des gleichen Apparates zu entnehmen gestattet, das also mit vergleichsweise geringem apparativen Aufwand und reduziertem Energieeinsatz auskommt, daß es

PCT/EP99/09915

die Produkte Silan (in Konzentrationen zwischen 96 bis 98 % SiH₄) und Siliciumtetrachlorid (in Konzentrationen z.B. zwischen 70 bis 80 % SiCl₄) in vergleichsweise hoher Konzentration zu erzeugen gestattet, ohne weitere Hilfsaggregate zu benötigen, daß es

- dank des festen unlöslichen Katalysators (im weiteren katalytisch wirksamer Feststoff genannt) nur minimalen Eintrag von Verunreinigungen aus dem Katalysator in die Reaktionsmischung aufweist und im Vergleich zu den flüssigen löslichen Katalysatoren einen deutlich geringeren Trennaufwand für die Abtrennung der Katalysatoren erfordert und auch die Ansammlung von flüchtigen, flüssigen Katalysatoren an bestimmten Kolonnenteilen strikt vermeidet und daß es
 - durch das Prinzip der Reaktivrektifikation den Energieaufwand für die Trennung der in den einzelnen Gleichgewichtsstufen der Disproportionierung entstehenden Silane oder Chorsilane minimiert.

25

30

Allerdings besteht ein schwerwiegender Nachteil dieses in der DE 2 507 864 beschriebenen Verfahrens darin, daß der für die Trennung der Silane oder Chlorsilane aufgewendete Energiebetrag vollständig auf einem den Kondensationstemperaturen entsprechenden sehr niedrigen Temperaturniveau abgeführt werden muß. Am Kopf der Kolonne muß nach DE 2 507 864 nämlich eine Temperatur unterhalb der Kondensationstemperatur von Monochlorsilan SiH₃Cl eingestellt werden und im Bereich des Einlaufs von Trichlorsilan SiHCl₃ eine Temperatur, die die Verdampfung des Trichlorsilans ermöglicht. Somit wird die zur Verdampfung der verschiedenen Chlorsilane und des Silans in den einzelnen Abschnitten der Kolonne erforderliche Energie

WO 00/39027 PCT/EP99/09915

letztlich bei einer Temperatur unterhalb der Kondensationstemperatur des Monochlorsilans abgeführt, also unterhalb von -50°C bis -120°C. Nun ist die Wärmeabfuhr auf niedrigem Temperaturniveau bekanntermaßen aufwendig und mit zusätzlichem Energieverbrauch verbunden und zwar zunehmend, je niedriger die Temperatur des Kühlmediums einzustellen ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein kontinuierliches Verfahren sowie eine Anlage zur Herstellung von Silan durch katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan zu Silan und Siliciumtetrachlorid anzugeben, bei dem die Disproportionierung reaktiv/destillativ an katalytisch wirkenden Feststoffen abläuft und Silan und Siliciumtetrachlorid in vergleichsweise hoher Konzentration gewonnen werden und der für die Trennung der disproportionierten Produkte und deren Kondensation erforderliche Aufwand minimiert ist. Die Wärmeabfuhr soll im wesentlichen bei einem Temperaturniveau erfolgen, bei dem Kühlmittel mit einer Temperatur die ohne hohen Aufwand erreichbar ist, einsetzbar sind, und der apparative und energetische Aufwand zur Kälteerzeugung für die Wärmeabfuhr zur Kondensation der Produkte soll reduziert werden.

Es wurde ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von SiH₄ durch katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid SiCl₄ in einem reaktiv/destillativen Reaktionsbereich mit Katalysatorbett aus katalytisch wirkendem Feststoff, in das SiHCl₃ eingeführt wird und woraus im Katalysatorbett erzeugtes leichter siedendes SiH₄-haltiges Produkt abgeführt und in einem Kopfkondensator kondensiert und als Endprodukt abgeführt wird, und in dem als schwerer siedendes Sumpfprodukt SiCl₄ gebildet wird, geschaffen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß das im Katalysatorbett unter einem Druck von 1 bis 50 bar erzeugte leichter siedende Produktgemisch bei einer Temperatur im Temperaturbereich von -25°C bis 50°C zwischenkondensiert und das dabei nicht kondensierte SiH₄-haltige Produktgemisch im Kopfkondensator kondensiert wird.

5

10

15

20

25

WO 00/39027 - 5 -

Geeignete katalytisch wirksame Feststoffe sind bekannt und auch in der DE 2 507 864 beschrieben. Es sind beispielsweise solche Feststoffe, die an einem Gerüst aus Polystyrol, vernetzt mit Divinylbenzol, Amino- oder Alkylenamino-Gruppen wie Dimethylamino-, Diethylamino-, Ethylmethylamino-, Di-n-propylamino-, Di-i-propylamino-, Di-2-chlorethylamino-, Di-2-Chlorpropylamino-Gruppen und deren Hydrochloride oder aber die durch Methylierung, Ethylierung, Propylierung, Butylierung, Hydroxyethylierung oder Benzylierung und daraus gebildete Trialkylammo-nium-Gruppen mit Chlorid als Gegenion enthalten. Selbstverständlich können im Fall quartärer Ammoniumsalze oder protonierter Ammoniumsalze auch katalytisch wirksame Feststoffe mit anderen Anionen, z.B. Hydroxid, Sulfat, Hydrogensulfat, Bicarbonat u.a. in das erfindungsgemäße Verfahren eingeführt werden, eine Umwandlung in die Chloridform ist unter den Reaktionsbedingungen mit der Zeit aber unvermeidbar, was auch für organische Hydroxygruppen gilt.

PCT/EP99/09915

Ebenso sind geeignet Feststoffe, die aus einem Polyacrylsäure-Gerüst, speziell einem Polyacrylamid-Gerüst bestehen, das z.B. über eine Alkylgruppe Trialkylbenzylammonium gebunden hat.

Eine andere für das erfindungsgemäße Verfahren geeignete Gruppe katalytisch wirksamer Feststoffe sind solche, die an einem Polystyrol-Gerüst, vernetzt mit Divinylbenzol, Sulfonat-Gruppen angebunden haben, denen als Kationen tertiäre oder quartäre Ammoniumgruppen gegenüberstehen.

Im Regelfall sind makroporöse oder mesoporöse Austauscherharze besser als Gelharze geeignet. Weitere geeignete katalytisch wirksame Feststoffe sind solche, die auf einem festen anorganischen Gerüst wie Kieselsäure oder Zeolith angebundene organische Aminogruppen der obengenannten Art, z.B. solche mit einer 3-Siloxy-propyldimethylamino-Gruppe, tragen (US 4 701 430). Die geeigneten, katalytisch wirksamen Feststoffe werden üblicherweise in Perlform eingesetzt.

20

25

5

10

WO 00/39027 PCT/EP99/09915

Verschiedene geeignete Aktivierungs- und Vorbehandlungsmethoden für diese Katalysatoren sind in der Literatur beschrieben.

In vorteilhafter Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das SiH₄-haltige Produktgemisch zur Konzentrationserhöhung des SiH₄ noch vor Kondensation des SiH₄-Endprodukts von im Gemisch enthaltenen schwerer siedenden Chlorsilanen getrennt. Die Trennung erfolgt bevorzugt bei einem gegenüber der Zwischenkondensation erhöhtem Druck, so daß die Konzentration des SiH₄ bei höherem Temperaturniveau zu erreichen ist und somit bei höherer SiH₄-Konzentration eine geringere Produktmenge zu kondensieren ist. Beim Trennen erhaltenes Chlorsilan wird zweckmäßig in den reaktiv/destillativen Reaktionsbereich zurückgeführt.

5

10

15

20

25

Die Erfindung und weitere Ausgestaltungen der Erfindung werden nachfolgend anhand von Anlagen zur Durchführung des Verfahrens und entsprechenden Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Zeichnung zeigt im einzelnen:

- Figur 1 Anlage zur Gewinnung von Silan mit reaktiv/destillativem Reaktionsbereich, mit Zwischenkondensator und integriertem Verstärkerteil und einem dem Verstärkerteil nachgeschaltetem externen Kopfkondensator zur Kondensation von Silan;
- Figur 2 Anlage zur Gewinnung von Silan mit reaktiv/destillativem Reaktionsbereich, mit Zwischenkondensator und integriertem Verstärkerteil, einem dem Verstärkerteil nachgeschalteten externen Kondensator, diesem nachgeschalteter Trennkolonne und an der Trennkolonne angeschlossenem Kopfkondensator zur Kondensation von Silan.
- Figur 3 Ausführung mit extern angeordneten Reaktoren.

In Figur 1 ist ein Fließschema einer Anlage zur kontinuierlichen Gewinnung von Silan SiH4 dargestellt, die eine im wesentlichen senkrecht stehende Reaktions-

WO 00/39027 - 8 -

Twischenkondensators 6 eingesetzt und in die Reaktionskolonne 1 integriert. Der Verstärkerteil kann aber auch außerhalb der Reaktionskolonne angeordnet sein. Das verstärkerteil 7 abziehende Produktgemisch wird schließlich vom Kopf der Reaktionskolonne über einen Abzug 8 in einen Kopfkondensator 9 geleitet, dort niedergeschlagen und als erhaltenes SiH₄-Endprodukt über eine SiH₄-Produktleitung 10 flüssig abgeführt. Ein Teil des gewonnenen SiH₄ wird über eine Zweigleitung 11 zum Kopf der Reaktionskolonne 1 zurückgeführt. Die Zweigleitung 11 mündet in die Kolonne oberhalb des Verstärkerteils 7.

PCT/EP99/09915

10

15

20

5

Im Kopfkondensator 9 bei Kondensation des SiH₄ als Rest anfallende inerte Gasanteile werden vom Kopfkondensator über eine Inertgasleitung 12 abgezogen.

Erfindungsgemäß wird im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 nach Kondensation des am Kopf der Reaktionskolonne 1 abgezogenen Produkts im Kopfkondensator 9 Silan in einer Konzentration von >70 %, bevorzugt >90 %, besonders bevorzugt >98 % gewonnen. Dabei erfolgt nach Disproportionierung von SiHCl3 im reaktiv/ destillativen Reaktionsbereich 2 eine Zwischenkondensation des vom Reaktionsbereich zum Kopf der Reaktionskolonne 1 hin strebenden leichter siedenden SiH₄haltigen Produktes. Statt eines Zwischenkondensators, wie im Ausführungsbeispiel, lassen sich auch mehrere Zwischenkondensatoren übereinander einsetzen. Der oder die Zwischenkondensatoren 6 arbeiten bei Temperaturen, bei denen die Abführung der Kondensationswärme mit einem Kühlmedium noch zwischen -25°C und 50°C möglich ist, bevorzugt zwischen -5°C und 40°C, so daß nur ein anteiliger wesentlich kleinerer, nicht kondensierter Teil des SiH4-haltigen Produktgemisches einem mit normalen Einbauten für die Destillation wie Böden und Packungen ausgestatteten Verstärkerteil 7 zugeführt werden muß, und nur der aus dem Verstärkerteil abziehende Gasanteil ist schließlich im Kopfkondensator 9 bei sehr tiefen Temperaturen zu kondensieren.

25

WO 00/39027 PCT/EP99/09915

kolonne 1 mit einem reaktiv destillativen Reaktionsbereich 2 zur katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ aufweist. Die Disproportionierung im Reaktionsbereich 2 erfolgt in einem Katalysatorbett 2', das aus einer für die Disproportionierungsprodukte durchströmbaren Schüttgutschicht aus Festkörpern aus katalytisch wirksamen Feststoffen besteht. Statt einer Schüttgutschicht können im Reaktionsbereich auch gepackte Katalysatorkörper vorgesehen sein. Als katalytisch wirksame Feststoffe werden bevorzugt in der DE 2 507 864 beschriebene Feststoffe eingesetzt, wie sie oben angegeben sind.

5

15

20

25

30

Das SiHCl₃ wird der Reaktionskolonne 1 über einen Zulauf 3 zugeführt, der in die Kolonne an geeigneter Stelle mündet. Im Reaktionsbereich 2 wird durch Disproportionierung von SiHCl₃ ein SiH₄-haltiges, im Reaktionsbereich aufsteigendes Produktgemisch, und ein SiCl₄ enthaltendes, im Reaktionsbereich abströmendes Kondensat gebildet.

Das aus dem Reaktionsbereich austretende SiCl₄ enthaltende Kondensat wird in der Reaktionskolonne 1 in einen unterhalb des reaktiv/destillativen Reaktionsbereichs 2 angeordneten destillativen Abtriebsteil 4 eingeführt, unter dem sich dann ein Sumpfverdampfer 5 befindet, aus dem als Sumpfprodukt Siliciumtetrachlorid SiCl₄ über einen Abfluß 13 abfließt. Über den Wärmetauscher 5 erfolgt der erforderliche Wärmeeintrag in die Reaktionskolonne zur Disproportionierung von SiHCl₃.

Für das im Reaktionsbereich 2 aufsteigende SiH₄-haltige Produktgemisch ist oberhalb des Reaktionsbereichs ein Zwischenkondensator 6 vorgesehen, in dem durch Teilkondensation von schwerer siedenden Komponenten bei einer Temperatur zwischen -25°C und 50°C, bevorzugt zwischen -5°C und 40°C, die Konzentration von SiH₄ im Produktgemisch erhöht wird. Die Kondensationswärme wird von einem den Zwischenkondensator 6 durchströmenden Kühlmedium abgeführt. Die im Zwischenkondensator 6 nicht kondensierten, leichter siedenden Produktanteile werden zur weiteren Konzentrationserhöhung in einen dem Zwischenkondensator in Strömungsrichtung der aufsteigenden Produktanteile nachgeschalteten Verstärkerteil 7 zugerichtung der aufsteigenden Produktanteile nachgeschalteten Verstärkerteil 7 zugerichtung

WO 00/39027 - 9 -

Der Verstärkerteil 7 samt zugehörigem Kopfkondensator 9 kann auch außerhalb der Reaktionskolonne 1 extern angeordnet sein.

PCT/EP99/09915

Bei den üblicherweise angewendeten Drücken von 1 bis 50 bar, bevorzugt 1 bis 10 bar, und den gewünschten Reinheiten des Silanprodukts ist der Kopfkondensator 9 unterhalb der Kondensationstemperaturen von < - 40° C, meist sogar unter < - 60° C zu betreiben. Durch die Installation rein destillativer Trennabschnitte vor Kondensation des Silan-Endprodukts und das Anordnen eines destillativen Abtriebsteils 4 oberhalb des Sumpfverdampfers 5 wird die eingetragene Energie mehrfach genutzt, und zwar (1) zur Reinigung und Konzentrierung des Silans im Verstärkerteil 7, (2) zur ständigen destillativen Entfernung der bezogen auf die jeweiligen lokalen apparativen Verhältnisse leichter siedenden Zwischenprodukte bzw. Produkte und damit zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich 2, und (3) zur Reinigung des SiCl₄ im unteren Teil der Reaktionskolonne. Durch den destillativen Abtriebsteil 4 und die dadurch mögliche Reinigung des am Sumpf entnommenen SiCl₄ entsteht ein weiterer Vorteil gegenüber dem aus DE 2 507 864 bekannten Verfahren, weil eine nachfolgende Kolonne zur Reinigung des SiCl₄ entfallen kann und somit auch für diesen Verfahrensschritt erforderliche Energie eingespart wird.

20

25

30

15

5

10

Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist in Figur 2 dargestellt. Bei diesem Beispiel entspricht die Reaktionskolonne 1a in ihrem Aufbau weitgehend der Ausbildung der Reaktionskolonne 1 nach Figur 1. Alle Apparateteile, die analog den Teilen nach Figuren 1 und 2 gestaltet sind, werden deshalb mit gleichen Bezugszeichen, jedoch zur Unterscheidung jeweils mit angefügtem Index "a" angegeben.

Die Trennkolonne 14 ist beim Ausführungsbeispiel nach Figur 2 einem Kondensator 9a nachgeschaltet, der zwischen Verstärkerteil 7a und Trennkolonne 14 angeordnet ist. Im Kondensator 9a wird das aus dem Verstärkerteil 7a über den Abzug 8a abströmende, nicht kondensierte SiH₄-haltige Produktgemisch vor Eintritt in die Trennkolonne 14 zumindest zu einem Teil kondensiert, so daß in die Trennkolonne

WO 00/39027 PCT/EP99/09915

14 ein an SiH₄ höher aufkonzentriertes Produktgemisch eingeführt wird. Vom im Kondensator 9a erzeugten Kondensat wird ein Teil über eine Zweigleitung 11a in die Reaktionskolonne 1a oberhalb ihres Verstärkerteils 7a zurückgeführt. Der übrige Teil des Kondensats wird von einer Flüssigkeitspumpe 15 komprimiert und in einer Druckleitung 16 zur Trennkolonne 14 geführt. Wird im Kondensator 9a nur ein Teil des vom Verstärkerteil 7a abziehenden Produktgemisches kondensiert, wird der Rest über einen Abzug 12a mittels eines Kompressors 17 abgesaugt und komprimiert über eine Druckleitung 16' in die Trennkolonne 14 eingeleitet. Alternativ kann der Strom 12a auch einer Aufarbeitung zugeführt werden.

10

15

20

25

30

5

Vom Kopf der Trennkolonne 14 führt ein Abzug 18 zu einem Kopfkondensator 19, aus dem das gewonnene kondensierte Silan in einer SiH4-Produktleitung 20 abgeführt wird. Ein Teil des flüssigen Silans wird in einer Zweigleitung 21 zurück in die Trennkolonne 14 geleitet. Im Kopfkondensator anfallende Inertgase strömen über eine Inertgasleitung 22 ab.

Vom Sumpf 23 der Trennkolonne 14 wird das Sumpfprodukt der Trennkolone über einen Sumpfabzug 24 abgeführt. Ein Teil des Sumpfprodukts fließt über die Zweigleitung 25 in die Reaktionskolonne 1a zurück, ein weiterer Teil wird über eine Rückführung 26 nach Verdampfung im Wärmetauscher 27 in den Sumpfbereich der Trennkolonne 14 zurückgeführt, ein weiterer Teil kann zur Ausschleusung von Verunreinigungen ganz aus der Anlage entnommen werden (28).

Im Ausführungsbeispiel nach Figur 2 wird zur Erhöhung der Kondensationstemperatur im Kondensator 9a und zur weiteren Absenkung der bei sehr niedriger Temperatur abzuführenden Kondensationsenergie durch Minderung der Rücklaufmenge gegenüber dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 und vollständiges oder teilweises Kondensieren im Kondensator 9a ein flüssiges oder gasförmiges Kopfprodukt mit geringerer Silanreinheit zwischen 25 % bis 90 % erzeugt. Dieses Kopfprodukt wird dann zur weiteren Reinigung in der nachgeschalteten Trennkolonne 14 getrennt, wobei ein gleicher oder vorzugsweise höherer Druck als in der Reaktionskolonne 1a.

PCT/EP99/09915

vorzugsweise 15 bar bis 100 bar, eingestellt ist, so daß die Trennkolonne 14 folglich bei höheren Temperaturen, bezogen auf gleiche Zusammensetzung, arbeitet als die Reaktionskolonne 1a. Auch bei dieser Variante kann das Sumpfprodukt der getrennt stehenden Trennkolonne 14 abhängig von den gewählten Betriebsbedingungen große stehenden Trichlorsilan, Dichlorsilan und Monochlorsilan enthalten. Das Sumpfprodukt Anteile Trichlorsilan, Dichlorsilan und Monochlorsilan enthalten. Das Sumpfprodukt wird über die am Abzug 24 angeschlossene Zweigleitung 25 ganz oder teilweise in die Reaktionskolonne 1a zurückgeführt. Durch Ausschleusen eines Teilstroms können gegebenenfalls Verunreinigungen aus dem System entfernt werden (28).

Die Zulaufmenge oder die Zulaufmengen in die Reaktionskolonne über die Zuleitungen 3, 3a und 25, werden gegebenenfalls nach Vorreaktion in einem Vorreaktor in Abhängigkeit von der jeweiligen Zusammensetzung in den Abtriebsteil 4, 4a oder zwischen reaktiv/destillativen Reaktionsbereichen 2, 2a und Abtriebsteil oder in die reaktiv-destillative Reaktionszone oder in den Zwischenkondensator 6, 6a geführt.

15

20

5

Das erfindungsgemäße Verfahren wird bei Drücken von 1 bis 50 bar, vorzugsweise 1 bis 10 bar, besonders bevorzugt 2,8 bis 5 bar, im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich mit katalytisch wirksamen Feststoffen betrieben. Mit den Drücken werden die Temperaturen im System beeinflußt. Die Temperaturen in demjenigen Abschnitt des reaktiv/destillativen Reaktionsteils, in dem die Disproportionierung stattfindet, liegen zwischen 30°C und 180°C, vorzugsweise zwischen 50°C und 110°C. Die jeweils einzustellende Temperatur richtet sich nach dem Stabilitätsbereich der eingesetzten katalytisch wirksamen Feststoffe.

25

30

Nachteil der früher beschriebenen Verfahren zur destillativen Abtrennung von reinem Silan bei überlagerter Reaktion ist die große Wärmemenge, die bei der Kondensationstemperatur des Silans bei gegebenem Druck, also z.B. bei -50°C bis Kondensationstemperaturen des Silans bei gegebenem Druck, also z.B. bei -50°C bis -120°C abgeführt werden muß. Die Kondensation bei diesen Temperaturen ist, wie bereits erläutert, wirtschaftlich sehr ungünstig. Die bei Betrieb ohne Zwischenkonbereits erläutert, wirtschaftlich sehr ungünstig. Die bei Betrieb ohne Zwischenkondensator abzuführende Wärmemenge liegt in der gleichen Größenordnung wie die den Sumpf der Reaktionskolonne zugeführte Wärmemenge und die für die Wärmemenge auch die Für die Wärmemenge und di

WO 00/39027 PCT/EP99/09915 - 12 -

abführ aufzubringenden Kosten dürften somit die Kosten für den Wärmeeintrag im allgemeinen deutlich übersteigen. Dies wird durch die erfindungsgemäße Zwischenkondensation größtenteils vermieden. Beispielsweise läßt sich schon bei Verwendung eines 25°C warmen Kühlmediums für die Zwischenkondensation zur Abkühlung des oberhalb des Zwischenkondensators bzw. oberhalb der Zwischenkondensatoren austretenden Gasstromes auf 40°C in Abhängigkeit vom Systemdruck 60 % bis 97 % der Kondensationswärme abführen, so daß nur noch 3 % bis 40 % der Kondensationswärme bei Kondensationstemperatur des Silans abgeführt werden müssen. Dennoch gelingt bereits oberhalb des Zwischenkondensators in einer direkt aufgesetzten und /oder in einer getrennten aufgestellten Trennkolonne ein Reinigung des Silans auf vorzugsweise mehr als 90 % SiH₄, besonders bevorzugt mehr als 98 % SiH₄, wobei der zur Kondensation des Silans geeignete Kondensationstemperatur des Silans betrieben wird.

15

20

25

30

10

5

Durch die Zwischenkondensation bleiben die Verhältnisse innerhalb der Reaktionszonen im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich gegenüber einer Reaktionskolonne ohne Zwischenkondensator im wesentlichen unverändert, so daß entstehende Zwischenprodukte und Produkte weiterhin ausreichend effektiv nach ihrem Entstehen destillativ abgetrennt werden können. Nur oberhalb des Zwischenkondensators sind die Dampf- und Flüssigkeitsströme gegenüber dem restlichen System deutlich reduziert. Sie reichen aber aus, um die im Vergleich zum Sumpfprodukt der Reaktionskolonne, dem SiCl₄, geringen Mengen an Silan, welches deutliche Siedepunktsunterschiede zu den restlichen Komponenten aufweist, in einer aufgesetzten oder getrennten Trennkolonne bis auf Reinheiten von >50 %, besonders bevorzugt >98 % aufzukonzentrieren.

Als Einbauten werden in der erfindungsgemäßen Anlage in den Reaktionskolonnen vorzugsweise solche verwendet, die einen intensiven Stoffaustausch zwischen Gasund Flüssigphase gewährleisten und gleichzeitig einen intensiven Kontakt zum festen Katalysator erlauben. Aufgrund der Kombination von Stoffübergang und Reaktion

5

10

15

20

25

30

PCT/EP99/09915

wird im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich durch die schnelle Abtrennung entstehender Produkte ein ausreichender Abstand vom jeweiligen chemischen Reaktionsgleichgewicht gewährleistet, so daß die Reaktion stets mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit verläuft. Beispiele für solche Kolonneneinbauten sind Böden, Packungen oder Füllkörper zum Einbringen heterogener Katalysatoren, wie sie z.B. in folgenden Druckschriften beschrieben sind: EP 670 178, EP 461 855, US 5 026 459, US 4 536 373, WO 94/08681, WO 94/08682, WO 94/08679, EP 470 655, WO 97/26971, US 5 308 451, EP 755 706, EP 781 829, EP 428 265, EP 448 884, EP 640 385, EP 631 813, WO 90/02603, WO 97/24174, EP 665 041, EP 458 472, EP 476 938 und deutsches Gebrauchsmuster 298 07 007.3. Es ist aber auch möglich, den festen Katalysator als solchen oder in einer agglomerierten Form auf Destillationsböden auszubreiten. Im Verfahren werden die Verweilzeit, das Katalysatorvolumen und die destillative Trennwirkung im Reaktionsbereich auf die Reaktionskinetik und die Stoffübergangskinetik abgestimmt, wobei das Optimum der Parameter stark von den Randbedingungen wie z.B. vom gewählten Katalysator, dem Stoffsystem und den gewählten Druck- und Temperaturbedingungen abhängt.

Alternativ kann der Katalysator in externe, gegebenenfalls temperierte Reaktoren eingebracht werden, wobei wechselweise die Flüssigphase von der Reaktionskolonne in den Reaktor und von dort zur Stofftrennung wieder zurück in die Kolonne geführt wird. Hierbei wirkt sich jedoch nachteilig aus, daß entstehende Produkte im allgewird. Hierbei wirkt sich jedoch nachteilig aus, daß entstehende Produkte im allgewird. Hierbei wirkt so schnell nach ihrer Entstehung destillativ abgetrennt werden können, meinen nicht so schnell nach ihrer Entstehung destillativ abgetrennt werden können, wie dies bei den vorgenannten Böden, Packungen und Füllkörpern der Fall ist. Zur Entkopplung unterschiedlicher Temperaturen innerhalb der Kolonne und in externen Reaktionen ist eine Temperierung der Stoffströme zwischen Kolonne und den Reaktoren möglich.

In Figur 3 ist der destillativ/reaktive Reaktionsbereich 2; 2a aus den Figuren 1 und 2 für die Ausführung mit extern angeordneten Reaktoren dargestellt. Das aus einem destillativen Teil 29 ablaufende flüssige Gemisch gelangt, gegebenenfalls über Wärmerückgewinnung und Temperierung 31 in einen von oben nach unten oder von

WO 00/39027 PCT/EP99/09915

unten nach oben durchströmten Reaktor 32 und daraus auf den nächsten destillativen Abschnitt. Die Sequenz "destillativer Abschnitt-Temperierung-Reaktor" läßt sich beliebig oft übereinander anordnen.

Die im Reaktionsbereich der Reaktionskolonnen ablaufende Disproportionierung wird gemäß der Erfindung durch eine rein destillative Abtrennung und Reinigung der an Kopf und Sumpf der Reaktionskolonnen auszuschleusenden Silan bzw. Siliciumtetrachlorid enthaltenden Produkte ergänzt. Die destillative Trennung wird mittels der üblichen Einbauten für die reine Destillation wie Böden, Packungen und Füllkörpern durchgeführt. Für die ablaufende schwerer siedende SiCl₄-Komponente ist es günstig, durch rein destillative Abtrennung unterhalb des reaktiv/destillativen Reaktionsbereiches im unteren Bereich der Reaktionskolonne ein weitgehend aufschozentriertes Siliciumtetrachlorid mit mehr als 70 % SiCl₄, vorzugsweise mehr 95 % SiCl₄, besonders bevorzugt mehr als 99 % SiCl₄ als Sumpfprodukt zu erzeugen und dieses dem Sumpf der Reaktionskolonne zu entnehmen.

PCT/EP99/09915 WO 00/39027 - 15 -

Bezugszeichenliste

5	Reaktionskolonne reaktiv/destillativer Reaktionsbereich Katalysatorbett SiHCl ₃ - Zuleitung destillativer Abtriebsteil Sumpfverdampfer Zwischenkondensator Zwischenkondensator Dampfabzug Kopfkondensator	1, 1a 2, 2a 2', 2a' 3, 3a 4, 4a 5, 5a 6, 6a 7, 7a 8, 8a 9, 9a 10, 10a
15 20	SiH ₄ -Produktleitung Zweigleitung Inertgasleitung SiCl ₄ -Abfluß Trennkolonne Flüssigkeitspumpe Druckleitung Kompressor Abzug	11, 11a 12, 12a 13, 13a 14 15 16 17 18 19 20
25 30	SiH ₄ -Produktleitung Zweigleitung Inertgasleitung Sumpf Sumpfabzug Zweigleitung Rückführung Wärmetauscher Ausschleusung Destillationsteil Wärmerückgewinnung Temperierung/Wärmetauscher	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
35	- 1.4mm	32

PCT/EP99/09915

Patentansprüche

1. Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Silan SiH₁ durch katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid SiCl₄ in einem reaktiv destillativen Reaktionsbereich mit Katalysatorbett aus katalytisch wirkendem Feststoff, in das SiHCl3 eingeführt wird und woraus im Katalysatorbett erzeugtes leichter siedendes SiH₄-haltiges Produkt abgeführt und in einem Kopfkondensator kondensiert und als Endprodukt abgeführt wird, und in dem als schwerer siedendes Sumpfprodukt SiCl₄ gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, daß das im Katalysatorbett unter einem Druck von 1 bis 50 bar erzeugte leichter siedende Produktgemisch bei einer Temperatur im Temperaturbereich von -25°C bis 50°C zwischenkondensiert und das dabei nicht kondensierte SiH₄-haltige Produktgemisch im Kopfkondensator kondensiert wird.

15

10

5

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck im Kata-2. lysatorbett 1 bis 10 bar beträgt.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischen-20 kondensation bei einer Temperatur im Temperaturbereich zwischen -5°C und 40°C erfolgt.
 - Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das an Kopf-4. kondensator anfallende Produktgemisch bei einem gegenüber der Zwischenkondensation erhöhtem Druck getrennt wird.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4. dadurch gekennzeichnet, daß das Chlorsilan zumindest zu einem Teil in den reaktiv/destillativen Reaktionsbereich zurückgeführt wird.

25

PCT/EP99/09915 WO 00/39027 - 17 -

5

10

15

- Anlage zur Herstellung von Silan SiH4 in kontinuierlicher Weise durch Disproportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid 6. SiCl₄ in einer Reaktionskolonne (1, 1a) mit einem reaktiv/destillativen Reaktionsbereich (2, 2a), der ein von Festkörpern aus katalytisch wirkendem Feststoff gebildetes, von den Disproportionierungsprodukten und Trichlorsilan durchströmbares Katalysatorbett (2', 2a') aufweist, mit einem Zulauf (3, 3a) für SiHCl₃ zum Reaktionsbereich, sowie mit einem an der Reaktionskolonne angeschlossenem Kopfkondensator (9, 9a) zur Kondensation von erzeugtem SiH₄-haltigen Produkt und einem Abzug für kondensiertes SiH₄ am Kopfkondensator (10, 10a), und mit einem Abfluß (13, 13a) an der Reaktionskolonne für als Sumpfprodukt anfallendes SiCl₄, zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen reaktiv/ destillativem Reaktionsbereich (2, 2a) und Kopfkondensator (9, 9a) zumindest ein Zwischenkondensator (6, 6a) angeordnet ist, der bei einer Temperatur im Temperaturbereich von -25°C bis 50°C betrieben wird.
 - 7. Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Zwischenkondensator (6, 6a) eine Temperatur im Temperaturbereich von -5°C bis 40°C eingestellt ist.
 - 8. Anlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwischenkondensator (6, 6a) oberhalb des Katalysatorbettes (2', 2a') angeordnet ist.
- Anlage nach einem der Ansprüche 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß dem Zwischenkondensator (6, 6a) in Strömungsrichtung des vom Zwischenkondensator abströmenden leichter siedenden Produktgemisches ein Verstärkerteil (7, 7a) zur Erhöhung der SiH₄-Konzentration im Produktgemisch nachgeschaltet ist.
 - 30 10. Anlage nach einem der Ansprüche 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß dem Zwischenkondensator (6a) in Strömungsrichtung des vom Zwischen-

WO 00/39027 PCT/EP99/09915 - 18 -

kondensator abströmenden leichter siedenden Produktgemischs eine Trennkolonne (14) zur Trennung SiH₄-haltiger Produktanteile von schwerer siedenden Chlorsilan-Komponenten nachgeschaltet ist.

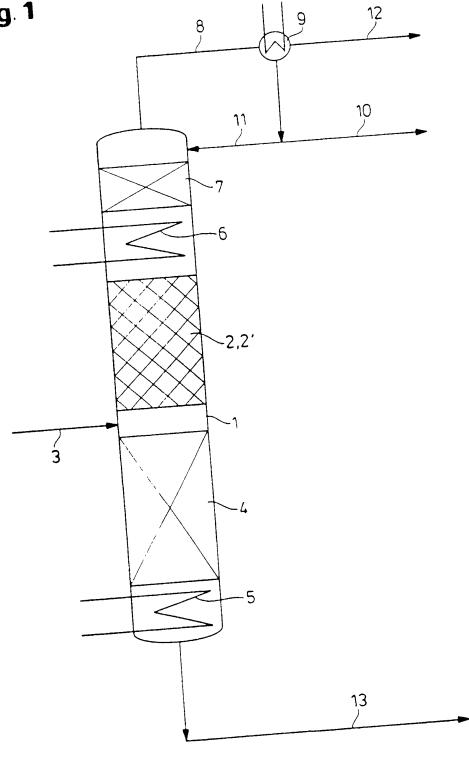
5 11. Anlage nach Anspruch 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennkolonne (14) dem Verstärkerteil (7a) nachgeschaltet ist.

10

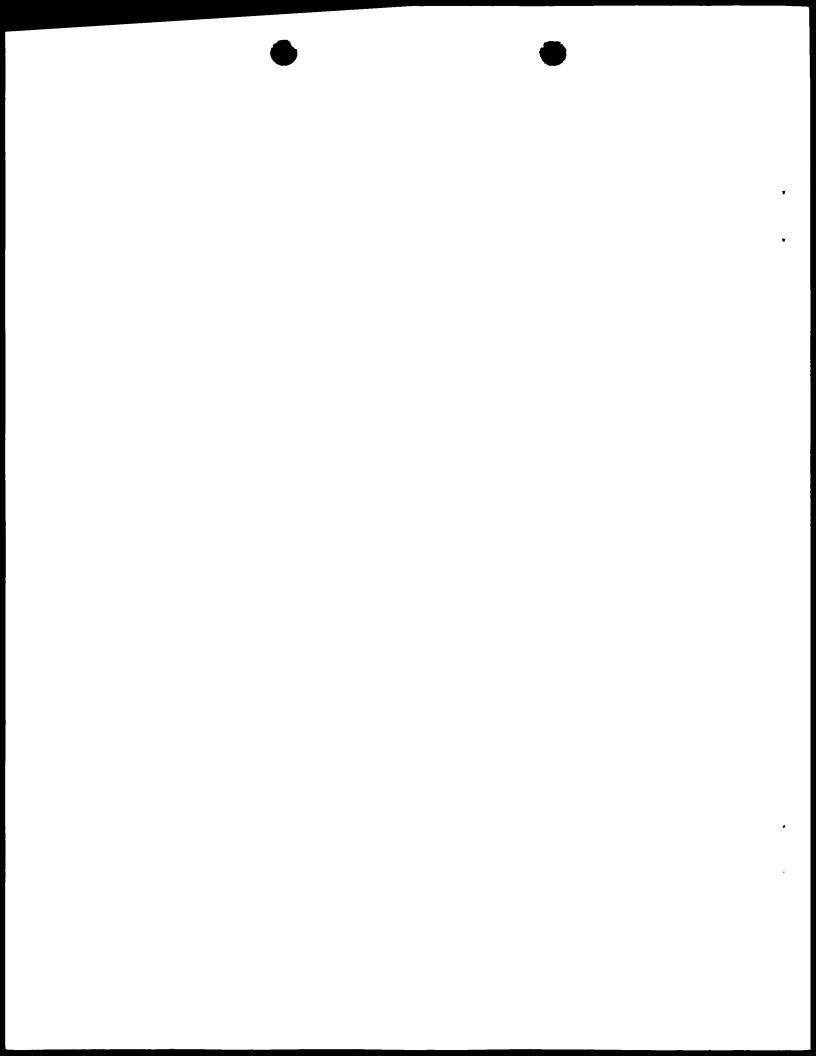
15

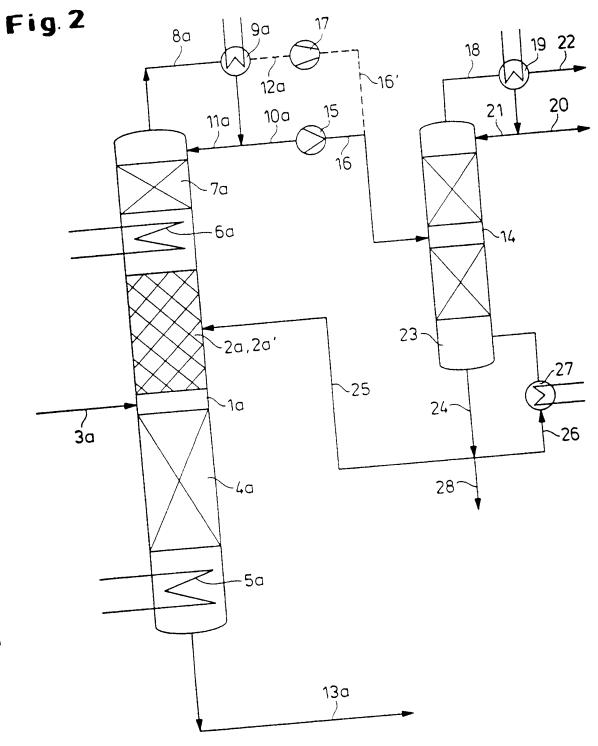
- 12. Anlage nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Verstärkerteil (7a) und Trennkolonne (14) ein Kondensator (9a) angeordnet ist.
- 13. Anlage nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennkolonne (14) bei einem gegenüber dem Zwischenkondensator (6, 6a) erhöhtem Druck arbeitet und das zur Trennkolonne (14) geführte Produkt komprimiert wird.
- 14. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß am Sumpfabzug (24) der Trennkolonne (14) eine Zweigleitung (25) angeschlossen ist, die in den reaktiv/destillativen Reaktionsbereich (2a) der Reaktionskolonne (1a) mündet.

Fig.1



ERSATZBLATT (REGEL 26)





ERSATZBLATT (REGEL 26)

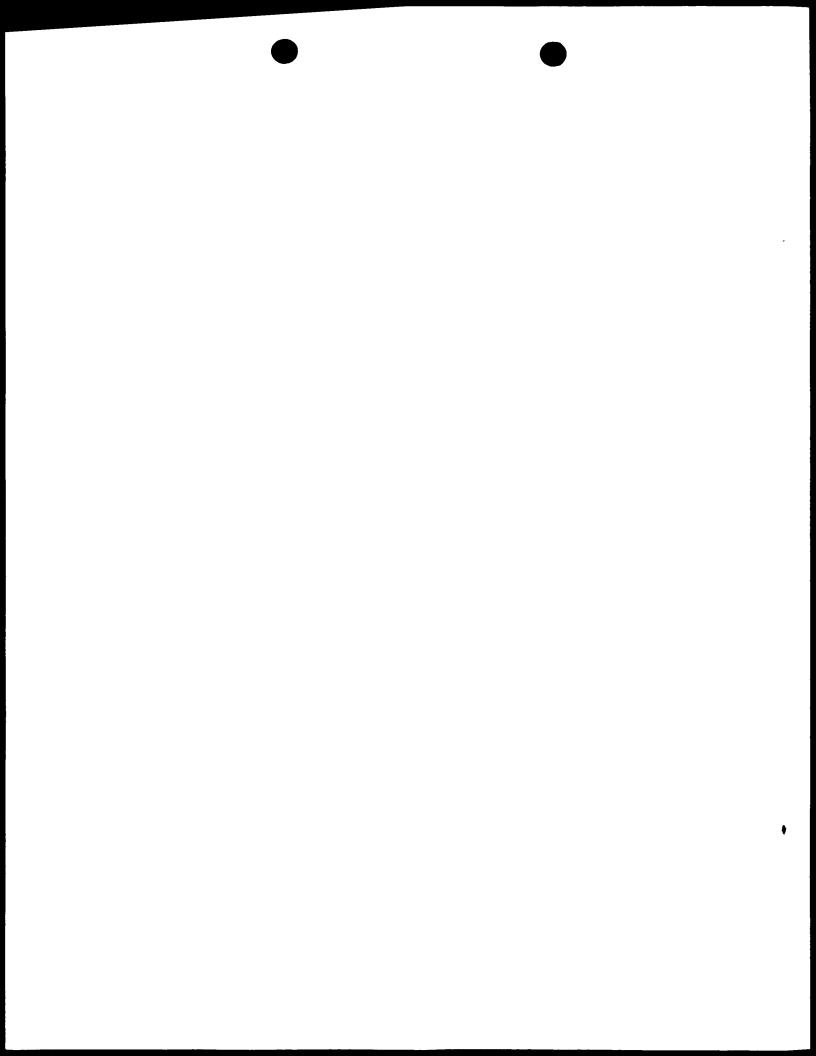
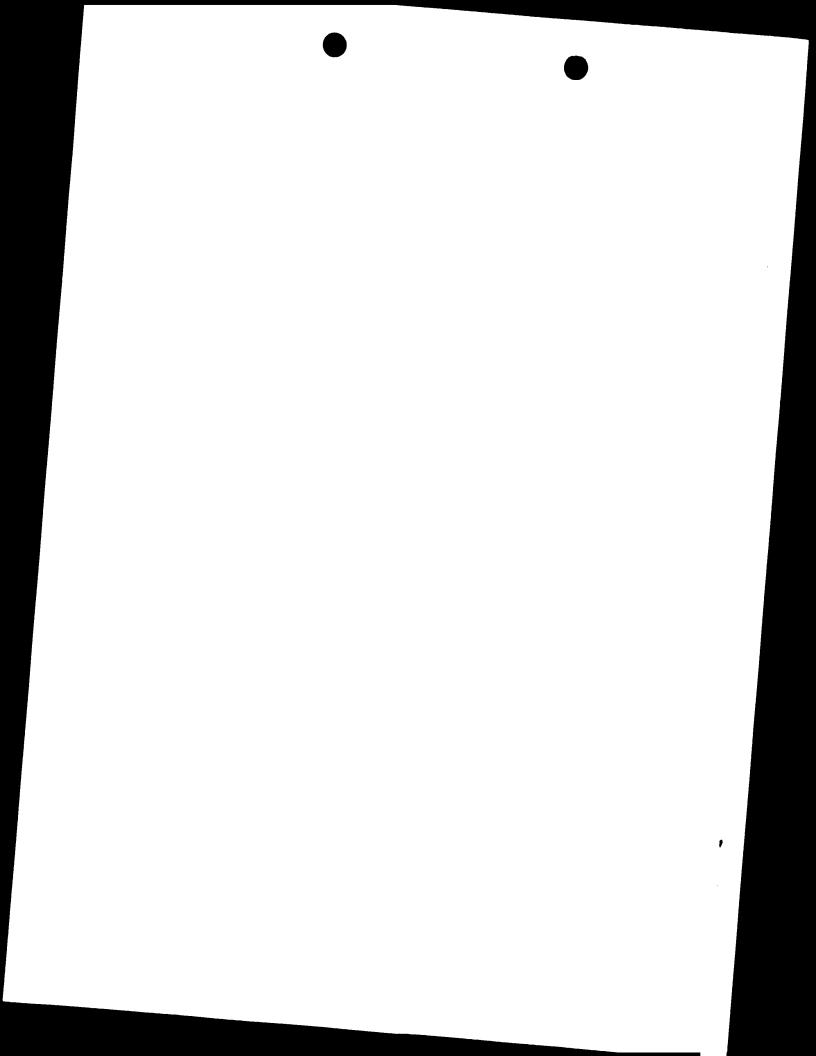


Fig. 3

29
30
31
32
32
32





ional Application No

PCT/EP 99/09915 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C01B33/04 B01J B01J8/02 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched IPC 7 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) Relevant to claim No. C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 1,6 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 013 (C-397) Α 14 January 1987 (1987-01-14) & JP 61 191513 A (DENKI KAGAKU KOGYO KK), 26 August 1986 (1986-08-26) 1,6 abstract FR 2 261 977 A (UNION CARBIDE CORP) 19 September 1975 (1975-09-19) A claims 5-20 figures 1-3 & DE 25 07 864 A cited in the application 1,6 EP 0 063 067 A (RHONE POULENC SPEC CHIM) 20 October 1982 (1982-10-20) A claims 1,5 -/--Patent family members are listed in annex. X Further documents are listed in the continuation of box C. T* later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the investigation. X Special categories of cited documents: *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to invention as invention of the document in th involve an inventive step when the document is taken alone *E* earlier document but published on or after the international "y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document as combination being children to a such combination being children to a such combination being children. "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) The second results of the control of the second second results of the second results of *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or *&* document member of the same patent family *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 02/05/2000 20 April 2000 Authorized officer Name and mailing address of the ISA NL - 2280 HV Rijawijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Rigondaud, B



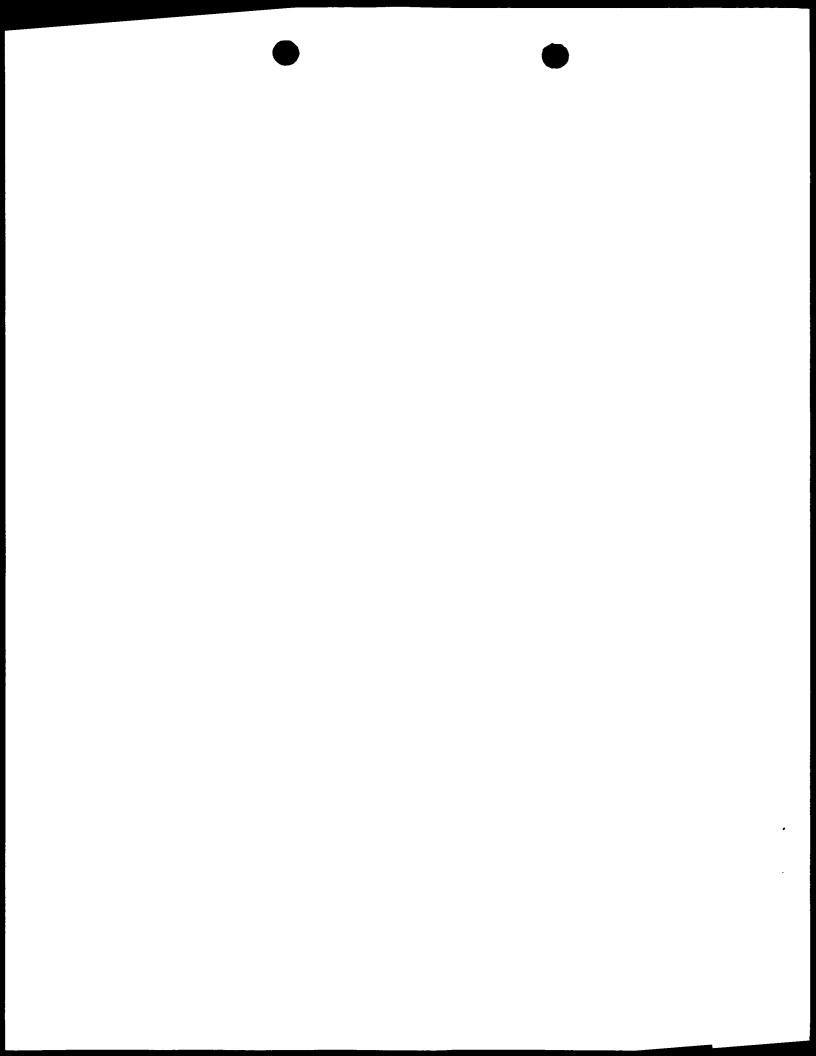


Inte. onal Application No PCT/EP 99/09915

		PCI/EP 99	7/09915
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	US 4 613 491 A (JUNG IL N ET AL) 23 September 1986 (1986-09-23)		
A	FR 2 118 725 A (UNION CARBIDE CORP) 28 July 1972 (1972-07-28)		
A	EP 0 093 640 A (RHONE POULENC SPEC CHIM) 9 November 1983 (1983-11-09)		

onal Application No PCT/EP 99/09915

INTERN	IONAL SELECT	ers.	PCT/EP 9	9/09915	
Infor	nation on patent family memb	Patent f	amily	Publication date	ı
Patent document cited in search report	Publication date	٠,	779573 C 071008 B	13-08-1993 12-11-1992	
JP 61191513 A FR 2261977 A	19-09-1975	US 3 BE DE 4	968199 A 825872 A 2507864 A 1499137 A 0119798 A	06-07-1976 25-08-1975 28-08-1975 25-01-1978 19-09-1975	
EP 0063067 A	20-10-1982	FR AT CA	2503125 A 5395 T 1164185 A 3260012 D 57209816 A 4405590 A	08-10-1982 15-12-1983 27-03-1984 29-12-1983 23-12-1982 20-09-1983	
US 4613491 A	23-09-1986	KR KR JP JP JP JP JP US	8600661 B 8600993 B 1868090 C 60244340 A 1416617 C 61006116 A 62018483 B 4701430 A	29-05-1986 26-07-1986 26-08-1994 04-12-1985 22-12-1987 11-01-1986 23-04-1987 20-10-1987	
FR 2118725	A 28-07-197	Z AU BE CA DE GB JP NI BI	465756 E 3650271 776794 988275 2162537 1377504 52018678 7117278 784818	09-10-1975 14-06-1973 16-06-1972 04-05-1976 A 13-07-1972 A 18-12-1974 A 23-05-1977 20-06-1972 A,B, 13-12-1978	3
EP 0093640	A 09-11-1		R 2526003 DE 3364499 DP 140597 JP 5905461 JP 6201216	04-11-1983 3 A 21-08-1980 5 C 27-10-198 5 C 29-03-198	5 7 4





Int. Jonales Aktenzeichen

PCT/EP 99/09915 A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C01B33/04 B01J8/02 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowert diese unter die recherchierten Gebiete fallen IPK 7 Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) Betr. Anspruch Nr. Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 1.6 Kategorie* PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 013 (C-397) 14. Januar 1987 (1987-01-14) A & JP 61 191513 A (DENKI KAGAKU KOGYO KK), 26. August 1986 (1986-08-26) 1,6 Zusammenfassung FR 2 261 977 A (UNION CARBIDE CORP) 19. September 1975 (1975-09-19) A Ansprüche 5-20 Abbildungen 1-3 & DE 25 07 864 A in der Anmeldung erwähnt 1,6 EP 0 063 067 A (RHONE POULENC SPEC CHIM) 20. Oktober 1982 (1982-10-20) A Ansprüche 1,5 -/--Siehe Anhang Patentfamilie *T° Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätadatum veröffentlicht worden list und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfortung zugnundelischenden Prinzins oder der ihr zugnundelischenden Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Anmekung nicht kolliktiert, sondern nur zum verstandnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzipe oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen *Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
erfinderische Tätigkeit betrachtet betrac *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteree Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist ernnoenscher i angker berunend betrachtet werden.

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen verden, wenn die Veröffentlichung einer Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist Anmeroegarum veromentiticht worden ist.

Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erveröffentlichung die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erveröffentlichung belegt werden anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden «ver
enderen im Recherchenbericht genannten Grund angegeben ist (wie entereffishet) ausgefuhrt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
eine Benutzung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 02/05/2000 Bevollmächtigter Bediensteter 20. April 2000 Name und Poetanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 Rigondaud, B Curopaned Falentianii, F.D. 3616 Falentia NL - 2280 HV Rijewijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

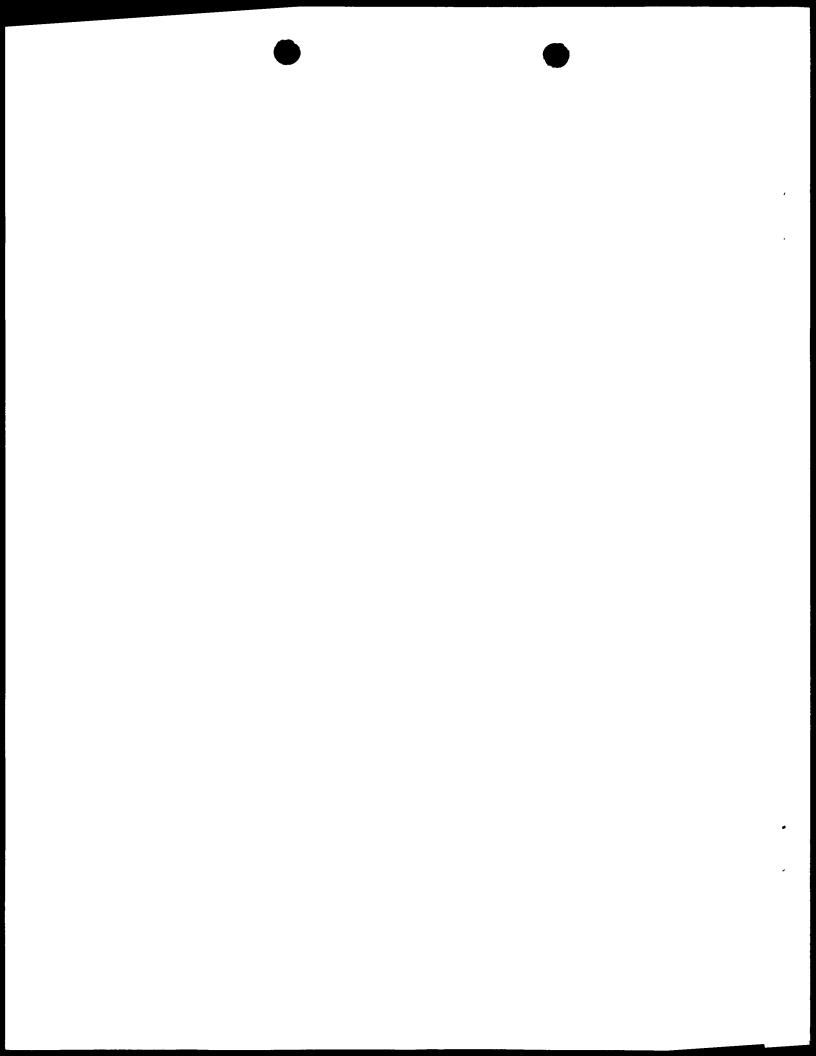
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inti donales Aktenzeichen
PCT/EP 99/09915

	PCI/	EP 99/09915
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
(ategone°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tei	le Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 613 491 A (JUNG IL N ET AL) 23. September 1986 (1986-09-23)	
A	FR 2 118 725 A (UNION CARBIDE CORP) 28. Juli 1972 (1972-07-28)	
Ą	EP 0 093 640 A (RHONE POULENC SPEC CHIM) 9. November 1983 (1983-11-09)	

onales Aktenzeichen PCT/EP 99/09915

NTERNATIONALE	ECHERCITE DE PROPERTIE GENÖRER	1	PCT/EP 9	9/09915
NTERNATIONALER I	zur seiben Paterintz			Datum der Veröffentlichung
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Veröffentlichung 26-08-1986	JP 1	1779573 C 4071008 B	13-08-1993 12-11-1992
JP 61191513 A FR 2261977 A	19-09-1975	US BE DE	3968199 A 825872 A 2507864 A 1499137 A	06-07-1976 25-08-1975 28-08-1975 25-01-1978 19-09-1975
EP 0063067 A	20–10–1982	FR AT CA DE JP	2503125 A 5395 T 1164185 A 3260012 D 57209816 A 4405590 A	08-10-1982 15-12-1983 27-03-1984 29-12-1983 23-12-1982 20-09-1983
US 4613491 A	23-09-1986	KR KR JP JP JP JP JP US	8600661 B 8600993 B 1868090 C 60244340 A 1416617 C 61006116 A 62018483 B 4701430 A	29-05-1986 26-07-1986 26-08-1994 04-12-1985 22-12-1987 11-01-1986 23-04-1987 20-10-1987
FR 2118725	28-07-1972	AU AU BE CA DE GB JP NI	465756 B 3650271 A 776794 A 988275 A 2162537 A 1377504 A 52018678 7117278 784818	13-07-1972 18-12-1974 23-05-1977 20-06-1972 A,B, 13-12-1972
EP 0093640	A 09-11-198	, s	R 2526003 PE 3364499 PP 1405975 PP 59054617 PP 62012168	A 04-11-1983 D 21-08-1986 C 27-10-198 C 29-03-198



Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

International application No PCT/EP99/09915 14 December 1999 (14.12.99) 24 December 1998 (24.12.98) 25 December 1998 (24.12.98) 25 December 1998 (24.12.98) 26 December 1998 (24		(PCT Article 30 and 14a.	
PCT/Ep99/09015 Ternational Patent Classification (IPC) or national classification and IPC COTATE 33/04 Repplicant BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of		FOR FURTHER ACTION Pre	iminary Examination Priority date (day/month year) Priority da
Applicant BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of	ernational application No PCT/EP99/09915	14 December 1999 (14.12	.99)
1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of	sternational Patent Classification (IPC)	or national classification and a	
2. This REPORT consists of a total of			
Priority Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability Lack of unity of invention Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability Certain documents cited VII Certain defects in the international application VIII Certain observations on the international application Date of completion of this report	2. This REPORT consists of a been amended and (see Rule 70.16 and These annexes con	total of7 sheets, including accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of are the basis for this report and/or sheets of Section 607 of the Administrative Instruction as the sheets. Sheets.	this cover sheet. f the description, claims and/or drawings which have rectifications made before this Authority
Date of completion of this report	II Priority III Non-es IV Lack of Citation VI Certa VII Certa VII Certa	stablishment of opinion with regard to no of unity of invention ned statement under Article 35(2) with re- ons and explanations supporting such state in documents cited	gard to novelty, inventive step or industrial applicability: ement
Date of submission of the demand 30 March 2001 (30.03.2001)	Date of submission of the de	mand	Date of completion of this report 30 March 2001 (30.03.2001)
06 June 2000 (06.06.00) Authorized officer	06 June	2000 (06.06.00)	
Name and mailing address of the IPEA/EP Telephone No.	Name and mailing address of	of the IPEA/EP	

5

10

15

20

25

30

können und dort z.B. unerwünschte Reaktionen katalysieren können. Auch gelingt es mit einem flüssigen Katalysator nicht, diesen möglichst gleichmäßig in der Kolonne zu verteilen, sondern er wird sich aufgrund seines spezifischen Dampfdrucks lokal aufkonzentrieren. Dieses Problem wird durch die in DE 3 500 318 vorgeschlagene Verwendung zweier Katalysatoren mit unterschiedlichen Siedepunkten keinesfalls behoben, sondern allenfalls gemindert.

Es ist auch bereits versucht worden, die nach dem Stand der Technik in mehreren Schritten, beispielsweise in zwei Schritten ablaufende Disproportionierung in einem Schritt nach dem Prinzip der Reaktivdestillation ablaufen zu lassen. Die Reaktivdestillation ist durch Kombination von Reaktion und destillativer Trennung in einem Apparat, insbesondere einer Kolonne gekennzeichnet. Durch die fortlaufende destillative Entfernung der jeweils leichtest siedenden Komponente in jedem Raumelement wird stets ein optimales Gefälle zwischen Gleichgewichtszustand und tatsächlichem Gehalt an leichter siedenden Komponenten bzw. leichtest siedender Komponente aufrecht erhalten, so daß eine maximale Reaktionsgeschwindigkeit resultiert (JP-01 317 114).

Aus der DE 2 507 864 ist ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Silan bekannt, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man in ein Bett eines im Reaktionsmedium unlöslichen Anionenaustauscherharzes, enthaltend tertiäre Amino- oder quaternäre Ammoniumgruppen an einem Kohlenstoffatom, Trichlorsilan einführt und die Temperatur des Harzbettes so hält, daß Trichlorsilan disproportioniert wird einerseits zu Produkten, die im Bett aufsteigen, und andererseits zu Siliciumtetrachlorid, das kondensiert und zum Kolonnensumpf fließt, und daß man die Temperatur am oberen Teil des Bettes über dem Siedepunkt von Silan und unter dem Siedepunkt von Monochlorsilan hält und das von Chlorsilanen praktisch freie Silan aus dem Bett gewinnt.

Dieses Verfahren zeichnet sich den anderen bekannten Verfahren gegenüber dadurch aus, daß es

(1) apparativ einstufig ist, also Silan und Siliciumtetrachlorid als gewünschte, angereicherte Produkte von verschiedenen Stellen des gleichen Apparates zu entnehmen gestattet, das also mit vergleichsweise geringem apparativen Aufwand und reduziertem Energieeinsatz auskommt, daß es

5

(2) die Produkte Silan (in Konzentrationen zwischen 96 bis 98 % SiH₄) und Siliciumtetrachlorid (in Konzentrationen z.B. zwischen 70 bis 80 % SiCl₄) in vergleichsweise hoher Konzentration zu erzeugen gestattet, ohne weitere Hilfsaggregate zu benötigen, daß es

 $\bigcirc 10$

dank des festen unlöslichen Katalysators (im weiteren katalytisch wirksamer Feststoff genannt) nur minimalen Eintrag von Verunreinigungen aus dem Katalysator in die Reaktionsmischung aufweist und im Vergleich zu den flüssigen löslichen Katalysatoren einen deutlich geringeren Trennaufwand für die Abtrennung der Katalysatoren erfordert und auch die Ansammlung von flüchtigen, flüssigen Katalysatoren an bestimmten Kolonnenteilen strikt vermeidet und daß es

15

(4) durch das Prinzip der Reaktivrektifikation den Energieaufwand für die Trennung der in den einzelnen Gleichgewichtsstufen der Disproportionierung entstehenden Silane oder Chorsilane minimiert.

20

25

30

Allerdings besteht ein schwerwiegender Nachteil dieses in der DE 2 507 864 beschriebenen Verfahrens darin, daß der für die Trennung der Silane oder Chlorsilane aufgewendete Energiebetrag vollständig auf einem den Kondensationstemperaturen entsprechenden sehr niedrigen Temperaturniveau abgeführt werden muß. Am Kopf der Kolonne muß nach DE 2 507 864 nämlich eine Temperatur unterhalb der Kondensationstemperatur von Monochlorsilan SiH₃Cl eingestellt werden und im Bereich des Einlaufs von Trichlorsilan SiHCl₃ eine Temperatur, die die Verdampfung des Trichlorsilans ermöglicht. Somit wird die zur Verdampfung der verschiedenen Chlorsilane und des Silans in den einzelnen Abschnitten der Kolonne erforderliche Energie

5

10

15

20

25

letztlich bei einer Temperatur unterhalb der Kondensationstemperatur des Monochlorsilans abgeführt, also unterhalb von -50°C bis -120°C. Nun ist die Wärmeabfuhr auf niedrigem Temperaturniveau bekanntermaßen aufwendig und mit zusätzlichem Energieverbrauch verbunden und zwar zunehmend, je niedriger die Temperatur des Kühlmediums einzustellen ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein kontinuierliches Verfahren sowie eine Anlage zur Herstellung von Silan durch katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan zu Silan und Siliciumtetrachlorid anzugeben, bei dem die Disproportionierung reaktiv/destillativ an katalytisch wirkenden Feststoffen abläuft und Silan und Siliciumtetrachlorid in vergleichsweise hoher Konzentration gewonnen werden und der für die Trennung der disproportionierten Produkte und deren Kondensation erforderliche Aufwand minimiert ist. Die Wärmeabfuhr soll im wesentlichen bei einem Tempe-Aufwand minimiert ist. Die Wärmeabfuhr soll im einer Temperatur die ohne hohen Aufraturniveau erfolgen, bei dem Kühlmittel mit einer Temperatur die ohne hohen Aufwand erreichbar ist, einsetzbar sind, und der apparative und energetische Aufwand zur Kälteerzeugung für die Wärmeabfuhr zur Kondensation der Produkte soll reduziert werden.

Es wurde ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von SiH₄ durch katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid SiCl₄ in einem reaktiv/destillativen Reaktionsbereich mit Katalysatorbett aus katalytisch wirkendem Feststoff, in das SiHCl₃ eingeführt wird und woraus im Katalysatorbett erzeugtes leichter siedendes SiH₄-haltiges Produkt abgeführt und in einem Kopferzeugtes leichter siedendes SiH₄-haltiges Produkt abgeführt wird, und in dem als schwerer kondensator kondensiert und als Endprodukt abgeführt wird, und in dem als schwerer siedendes Sumpfprodukt SiCl₄ gebildet wird, geschaffen, das dadurch gekennzeich net ist, daß das im Katalysatorbett unter einem Druck von 1 bis 50 bar erzeugte leichter siedende Produktgemisch bei einer Temperatur im Temperaturbereich von leichter siedende Produktgemisch bei einer Temperatur im Temperaturbereich von Produktgemisch im Kopfkondensiert und das dabei nicht kondensierte SiH₄-haltige Produktgemisch im Kopfkondensator kondensiert wird.

Geeignete katalytisch wirksame Feststoffe sind bekannt und auch in der DE 2 507 864 beschrieben. Es sind beispielsweise solche Feststoffe, die an einem Gerüst aus Polystyrol, vernetzt mit Divinylbenzol, Amino- oder Alkylenamino-Gruppen wie Dimethylamino-, Diethylamino-, Ethylmethylamino-, Di-n-propylamino-, Di-i-propylamino-, Di-2-chlorethylamino-, Di-2-Chlorpropylamino-Gruppen und deren Hydrochloride oder aber die durch Methylierung, Ethylierung, Propylierung, Butylierung, Hydroxyethylierung oder Benzylierung und daraus gebildete Trialkylammonium-Gruppen mit Chlorid als Gegenion enthalten. Selbstverständlich können im Fall quartärer Ammoniumsalze oder protonierter Ammoniumsalze auch katalytisch wirksame Feststoffe mit anderen Anionen, z.B. Hydroxid, Sulfat, Hydrogensulfat, Bicarbonat u.a. in das erfindungsgemäße Verfahren eingeführt werden, eine Umwandlung in die Chloridform ist unter den Reaktionsbedingungen mit der Zeit aber unvermeidbar, was auch für organische Hydroxygruppen gilt.

Ebenso sind geeignet Feststoffe, die aus einem Polyacrylsäure-Gerüst, speziell einem Polyacrylamid-Gerüst bestehen, das z.B. über eine Alkylgruppe Trialkylbenzylammonium gebunden hat.

Eine andere für das erfindungsgemäße Verfahren geeignete Gruppe katalytisch wirksamer Feststoffe sind solche, die an einem Polystyrol-Gerüst, vernetzt mit Divinylbenzol, Sulfonat-Gruppen angebunden haben, denen als Kationen tertiäre oder quartäre Ammoniumgruppen gegenüberstehen.

Im Regelfall sind makroporöse oder mesoporöse Austauscherharze besser als Gelharze geeignet. Weitere geeignete katalytisch wirksame Feststoffe sind solche, die auf einem festen anorganischen Gerüst wie Kieselsäure oder Zeolith angebundene organische Aminogruppen der obengenannten Art, z.B. solche mit einer 3-Siloxypropyldimethylamino-Gruppe, tragen (US 4 701 430). Die geeigneten, katalytisch wirksamen Feststoffe werden üblicherweise in Perlform eingesetzt.

5

20

5

10

15

20

25

Figur 2

Verschiedene geeignete Aktivierungs- und Vorbehandlungsmethoden für diese Katalysatoren sind in der Literatur beschrieben.

In vorteilhafter Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das SiH₄-lander Produktgemisch zur Konzentrationserhöhung des SiH₄ noch vor Kondensation des SiH₄-Endprodukts von im Gemisch enthaltenen schwerer siedenden Chlorsilanen getrennt. Die Trennung erfolgt bevorzugt bei einem gegenüber der Zwischensilanen gerhöhtem Druck, so daß die Konzentration des SiH₄ bei höherem kondensation erhöhtem Druck, so daß die Konzentration des SiH₄-Konzentration eine Temperaturniveau zu erreichen ist und somit bei höherer SiH₄-Konzentration eine geringere Produktmenge zu kondensieren ist. Beim Trennen erhaltenes Chlorsilan wird zweckmäßig in den reaktiv/destillativen Reaktionsbereich zurückgeführt.

Die Erfindung und weitere Ausgestaltungen der Erfindung werden nachfolgend anhand von Anlagen zur Durchführung des Verfahrens und entsprechenden Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Zeichnung zeigt im einzelnen:

Figur 1 Anlage zur Gewinnung von Silan mit reaktiv/destillativem Reaktionsbereich, mit Zwischenkondensator und integriertem Verstärkerteil und einem dem Verstärkerteil nachgeschaltetem externen Kopfkondensator zur Kondensation von Silan;

Anlage zur Gewinnung von Silan mit reaktiv/destillativem Reaktionsbereich, mit Zwischenkondensator und integriertem Verstärkerteil, einem dem Verstärkerteil nachgeschalteten externen Kondensator, diesem nachgeschalteter Trennkolonne und an der Trennkolonne angeschlossenem Kopfkondensator zur Kondensation von Silan.

Figur 3 Ausführung mit extern angeordneten Reaktoren.

In Figur 1 ist ein Fließschema einer Anlage zur kontinuierlichen Gewinnung von Silan SiH₄ dargestellt, die eine im wesentlichen senkrecht stehende Reaktions-

kolonne 1 mit einem reaktiv/destillativen Reaktionsbereich 2 zur katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ aufweist. Die Disproportionierung im Reaktionsbereich 2 erfolgt in einem Katalysatorbett 2', das aus einer für die Disproportionierungsprodukte durchströmbaren Schüttgutschicht aus Festkörpern aus katalytisch wirksamen Feststoffen besteht. Statt einer Schüttgutschicht können im Reaktionsbereich auch gepackte Katalysatorkörper vorgesehen sein. Als katalytisch wirksame Feststoffe werden bevorzugt in der DE 2 507 864 beschriebene Feststoffe eingesetzt, wie sie oben angegeben sind.

Das SiHCl₃ wird der Reaktionskolonne 1 über einen Zulauf 3 zugeführt, der in die Kolonne an geeigneter Stelle mündet. Im Reaktionsbereich 2 wird durch Disproportionierung von SiHCl₃ ein SiH₄-haltiges, im Reaktionsbereich aufsteigendes Produktgemisch, und ein SiCl₄ enthaltendes, im Reaktionsbereich abströmendes Kondensat gebildet.

15

5

Das aus dem Reaktionsbereich austretende SiCl₄ enthaltende Kondensat wird in der Reaktionskolonne 1 in einen unterhalb des reaktiv/destillativen Reaktionsbereichs 2 angeordneten destillativen Abtriebsteil 4 eingeführt, unter dem sich dann ein Sumpfverdampfer 5 befindet, aus dem als Sumpfprodukt Siliciumtetrachlorid SiCl₄ über einen Abfluß 13 abfließt. Über den Wärmetauscher 5 erfolgt der erforderliche Wärmeeintrag in die Reaktionskolonne zur Disproportionierung von SiHCl₃.

20

Für das im Reaktionsbereich 2 aufsteigende SiH₄-haltige Produktgemisch ist oberhalb des Reaktionsbereichs ein Zwischenkondensator 6 vorgesehen, in dem durch Teilkondensation von schwerer siedenden Komponenten bei einer Temperatur zwischen -25°C und 50°C, bevorzugt zwischen -5°C und 40°C, die Konzentration von SiH₄ im Produktgemisch erhöht wird. Die Kondensationswärme wird von einem den Zwischenkondensator 6 durchströmenden Kühlmedium abgeführt. Die im Zwischenkondensator 6 nicht kondensierten, leichter siedenden Produktanteile werden zur weiteren Konzentrationserhöhung in einen dem Zwischenkondensator in Strömungsrichtung der aufsteigenden Produktanteile nachgeschalteten Verstärkerteil 7 zugerichtung der aufsteigenden Produktanteile nachgeschalteten Verstärkerteil 7 zugerichtung der

30

führt. Im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 ist der Verstärkerteil 7 oberhalb des Zwischenkondensators 6 eingesetzt und in die Reaktionskolonne 1 integriert. Der Verstärkerteil kann aber auch außerhalb der Reaktionskolonne angeordnet sein. Das aus dem Verstärkerteil 7 abziehende Produktgemisch wird schließlich vom Kopf der Reaktionskolonne über einen Abzug 8 in einen Kopfkondensator 9 geleitet, dort Reaktionskolonne über einen Abzug 8 in einen Kopfkondensator 9 geleitet, dort niedergeschlagen und als erhaltenes SiH₄-Endprodukt über eine SiH₄-Produktleitung 10 flüssig abgeführt. Ein Teil des gewonnenen SiH₄ wird über eine Zweigleitung 11 zum Kopf der Reaktionskolonne 1 zurückgeführt. Die Zweigleitung 11 mündet in die Kolonne oberhalb des Verstärkerteils 7.

10

5

Im Kopfkondensator 9 bei Kondensation des SiH₄ als Rest anfallende inerte Gasanteile werden vom Kopfkondensator über eine Inertgasleitung 12 abgezogen.

20

15

Erfindungsgemäß wird im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 nach Kondensation des am Kopf der Reaktionskolonne 1 abgezogenen Produkts im Kopfkondensator 9 Silan in einer Konzentration von >70 %, bevorzugt >90 %, besonders bevorzugt >98 % gewonnen. Dabei erfolgt nach Disproportionierung von SiHCl₃ im reaktiv/ destillativen Reaktionsbereich 2 eine Zwischenkondensation des vom Reaktionsbereich zum Kopf der Reaktionskolonne 1 hin strebenden leichter siedenden SiH₄haltigen Produktes. Statt eines Zwischenkondensators, wie im Ausführungsbeispiel, lassen sich auch mehrere Zwischenkondensatoren übereinander einsetzen. Der oder die Zwischenkondensatoren 6 arbeiten bei Temperaturen, bei denen die Abführung der Kondensationswärme mit einem Kühlmedium noch zwischen -25°C und 50°C möglich ist, bevorzugt zwischen -5°C und 40°C, so daß nur ein anteiliger wesentlich kleinerer, nicht kondensierter Teil des SiH4-haltigen Produktgemisches einem mit normalen Einbauten für die Destillation wie Böden und Packungen ausgestatteten Verstärkerteil 7 zugeführt werden muß, und nur der aus dem Verstärkerteil abziehende Gasanteil ist schließlich im Kopfkondensator 9 bei sehr tiefen Temperaturen zu kondensieren.

Der Verstärkerteil 7 samt zugehörigem Kopfkondensator 9 kann auch außerhalb der Reaktionskolonne 1 extern angeordnet sein.

Bei den üblicherweise angewendeten Drücken von 1 bis 50 bar, bevorzugt 1 bis 10 bar, und den gewünschten Reinheiten des Silanprodukts ist der Kopfkondensator 9 unterhalb der Kondensationstemperaturen von < - 40°C, meist sogar unter < -60°C zu betreiben. Durch die Installation rein destillativer Trennabschnitte vor Kondensation des Silan-Endprodukts und das Anordnen eines destillativen Abtriebsteils 4 oberhalb des Sumpfverdampfers 5 wird die eingetragene Energie mehrfach genutzt, und zwar (1) zur Reinigung und Konzentrierung des Silans im Verstärkerteil 7, (2) zur ständigen destillativen Entfernung der bezogen auf die jeweiligen lokalen apparativen Verhältnisse leichter siedenden Zwischenprodukte bzw. Produkte und damit zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich 2. und (3) zur Reinigung des SiCl₄ im unteren Teil der Reaktionskolonne. Durch den destillativen Abtriebsteil 4 und die dadurch mögliche Reinigung des am Sumpf entnommenen SiCl₄ entsteht ein weiterer Vorteil gegenüber dem aus DE 2 507 864 bekannten Verfahren, weil eine nachfolgende Kolonne zur Reinigung des SiCl₄ entfallen kann und somit auch für diesen Verfahrensschritt erforderliche Energie eingespart wird.

20

15

5

10

Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist in Figur 2 dargestellt. Bei diesem Beispiel entspricht die Reaktionskolonne 1a in ihrem Aufbau weitgehend der Ausbildung der Reaktionskolonne 1 nach Figur 1. Alle Apparateteile, die analog den Teilen nach Figuren 1 und 2 gestaltet sind, werden deshalb mit gleichen Bezugszeichen, jedoch zur Unterscheidung jeweils mit angefügtem Index "a" angegeben.

25

30

Die Trennkolonne 14 ist beim Ausführungsbeispiel nach Figur 2 einem Kondensator 9a nachgeschaltet, der zwischen Verstärkerteil 7a und Trennkolonne 14 angeordnet ist. Im Kondensator 9a wird das aus dem Verstärkerteil 7a über den Abzug 8a abströmende, nicht kondensierte SiH₄-haltige Produktgemisch vor Eintritt in die Trennkolonne 14 zumindest zu einem Teil kondensiert, so daß in die Trennkolonne

14 ein an SiH₄ höher aufkonzentriertes Produktgemisch eingeführt wird. Vom im Kondensator 9a erzeugten Kondensat wird ein Teil über eine Zweigleitung 11a in die Reaktionskolonne 1a oberhalb ihres Verstärkerteils 7a zurückgeführt. Der übrige Teil des Kondensats wird von einer Flüssigkeitspumpe 15 komprimiert und in einer Druckleitung 16 zur Trennkolonne 14 geführt. Wird im Kondensator 9a nur ein Teil des vom Verstärkerteil 7a abziehenden Produktgemisches kondensiert, wird der Rest über einen Abzug 12a mittels eines Kompressors 17 abgesaugt und komprimiert über eine Druckleitung 16' in die Trennkolonne 14 eingeleitet. Alternativ kann der über eine Druckleitung 16' in die Trennkolonne 14 eingeleitet. Alternativ kann der

10

5

Vom Kopf der Trennkolonne 14 führt ein Abzug 18 zu einem Kopfkondensator 19, aus dem das gewonnene kondensierte Silan in einer SiH4-Produktleitung 20 abgeführt wird. Ein Teil des flüssigen Silans wird in einer Zweigleitung 21 zurück in die Trennkolonne 14 geleitet. Im Kopfkondensator anfallende Inertgase strömen über eine Inertgasleitung 22 ab.

20

15

Vom Sumpf 23 der Trennkolonne 14 wird das Sumpfprodukt der Trennkolone über einen Sumpfabzug 24 abgeführt. Ein Teil des Sumpfprodukts fließt über die Zweigleitung 25 in die Reaktionskolonne 1a zurück, ein weiterer Teil wird über eine Rückführung 26 nach Verdampfung im Wärmetauscher 27 in den Sumpfbereich der Trennkolonne 14 zurückgeführt, ein weiterer Teil kann zur Ausschleusung von Verunreinigungen ganz aus der Anlage entnommen werden (28).

25

Im Ausführungsbeispiel nach Figur 2 wird zur Erhöhung der Kondensationstemperatur im Kondensator 9a und zur weiteren Absenkung der bei sehr niedriger Temperatur abzuführenden Kondensationsenergie durch Minderung der Rücklaufmenge gegenüber dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 und vollständiges oder teilweises Kondensieren im Kondensator 9a ein flüssiges oder gasförmiges Kopfprodukt mit Kondensieren Silanreinheit zwischen 25 % bis 90 % erzeugt. Dieses Kopfprodukt wird geringerer Silanreinheit zwischen 25 % bis 90 % erzeugt. Trennkolonne 14 getrennt, dann zur weiteren Reinigung in der nachgeschalteten Trennkolonne 14 wobei ein gleicher oder vorzugsweise höherer Druck als in der Reaktionskolonne 1a.

vorzugsweise 15 bar bis 100 bar, eingestellt ist, so daß die Trennkolonne 14 folglich bei höheren Temperaturen, bezogen auf gleiche Zusammensetzung, arbeitet als die Reaktionskolonne 1a. Auch bei dieser Variante kann das Sumpfprodukt der getrennt stehenden Trennkolonne 14 abhängig von den gewählten Betriebsbedingungen große Anteile Trichlorsilan, Dichlorsilan und Monochlorsilan enthalten. Das Sumpfprodukt wird über die am Abzug 24 angeschlossene Zweigleitung 25 ganz oder teilweise in die Reaktionskolonne 1a zurückgeführt. Durch Ausschleusen eines Teilstroms können gegebenenfalls Verunreinigungen aus dem System entfernt werden (28).

10

Die Zulaufmenge oder die Zulaufmengen in die Reaktionskolonne über die Zuleitungen 3, 3a und 25, werden gegebenenfalls nach Vorreaktion in einem Vorreaktor in Abhängigkeit von der jeweiligen Zusammensetzung in den Abtriebsteil 4, 4a oder zwischen reaktiv/destillativen Reaktionsbereichen 2, 2a und Abtriebsteil oder in die reaktiv-destillative Reaktionszone oder in den Zwischenkondensator 6, 6a geführt.

15

5

Das erfindungsgemäße Verfahren wird bei Drücken von 1 bis 50 bar, vorzugsweise 1 bis 10 bar, besonders bevorzugt 2,8 bis 5 bar, im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich mit katalytisch wirksamen Feststoffen betrieben. Mit den Drücken werden die Temperaturen im System beeinflußt. Die Temperaturen in demjenigen Abschnitt des reaktiv/destillativen Reaktionsteils, in dem die Disproportionierung stattfindet, liegen zwischen 30°C und 180°C, vorzugsweise zwischen 50°C und 110°C. Die jeweils einzustellende Temperatur richtet sich nach dem Stabilitätsbereich der eingesetzten katalytisch wirksamen Feststoffe.

20

Nachteil der früher beschriebenen Verfahren zur destillativen Abtrennung von reinem Silan bei überlagerter Reaktion ist die große Wärmemenge, die bei der Kondensationstemperatur des Silans bei gegebenem Druck, also z.B. bei -50°C bis -120°C abgeführt werden muß. Die Kondensation bei diesen Temperaturen ist, wie bereits erläutert, wirtschaftlich sehr ungünstig. Die bei Betrieb ohne Zwischenkondensator abzuführende Wärmemenge liegt in der gleichen Größenordnung wie die am Sumpf der Reaktionskolonne zugeführte Wärmemenge und die für die Wärme-

abfuhr aufzubringenden Kosten dürften somit die Kosten für den Wärmeeintrag im allgemeinen deutlich übersteigen. Dies wird durch die erfindungsgemäße Zwischenkondensation größtenteils vermieden. Beispielsweise läßt sich schon bei Verwendung eines 25°C warmen Kühlmediums für die Zwischenkondensation zur Abkühlung des oberhalb des Zwischenkondensators bzw. oberhalb der Zwischenkondensatoren austretenden Gasstromes auf 40°C in Abhängigkeit vom Systemdruck densatoren austretenden Gasstromes auf 40°C in Abhängigkeit vom Systemdruck 60 % bis 97 % der Kondensationswärme abführen, so daß nur noch 3 % bis 40 % der Kondensationswärme bei Kondensationstemperatur des Silans abgeführt werden müssen. Dennoch gelingt bereits oberhalb des Zwischenkondensators in einer direkt aufgesetzten und /oder in einer getrennten aufgestellten Trennkolonne ein Reinigung des Silans auf vorzugsweise mehr als 90 % SiH₄, besonders bevorzugt mehr als 98 % SiH₄, wobei der zur Kondensation des Silans geeignete Kondensator am Kopf der Trennkolonne mit einer Kühlmitteltemperatur unterhalb der Kondensationstemperatur des Silans betrieben wird.

15

20

5

10

Durch die Zwischenkondensation bleiben die Verhältnisse innerhalb der Reaktionszonen im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich gegenüber einer Reaktionskolonne
ohne Zwischenkondensator im wesentlichen unverändert, so daß entstehende Zwischenprodukte und Produkte weiterhin ausreichend effektiv nach ihrem Entstehen
destillativ abgetrennt werden können. Nur oberhalb des Zwischenkondensators sind
die Dampf- und Flüssigkeitsströme gegenüber dem restlichen System deutlich
reduziert. Sie reichen aber aus, um die im Vergleich zum Sumpfprodukt der Reaktionskolonne, dem SiCl₄, geringen Mengen an Silan, welches deutliche Siedepunktsunterschiede zu den restlichen Komponenten aufweist, in einer aufgesetzten oder
getrennten Trennkolonne bis auf Reinheiten von >50 %, besonders bevorzugt >98 %
aufzukonzentrieren.

25

30

Als Einbauten werden in der erfindungsgemäßen Anlage in den Reaktionskolonnen vorzugsweise solche verwendet, die einen intensiven Stoffaustausch zwischen Gasund Flüssigphase gewährleisten und gleichzeitig einen intensiven Kontakt zum festen Katalysator erlauben. Aufgrund der Kombination von Stoffübergang und Reaktion

wird im reaktiv/destillativen Reaktionsbereich durch die schnelle Abtrennung entstehender Produkte ein ausreichender Abstand vom jeweiligen chemischen Reaktionsgleichgewicht gewährleistet, so daß die Reaktion stets mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit verläuft. Beispiele für solche Kolonneneinbauten sind Böden, Packungen oder Füllkörper zum Einbringen heterogener Katalysatoren, wie sie z.B. in folgenden Druckschriften beschrieben sind: EP 670 178, EP 461 855, US 5 026 459, US 4 536 373, WO 94/08681, WO 94/08682, WO 94/08679, EP 470 655, WO 97/26971. US 5 308 451, EP 755 706, EP 781 829, EP 428 265, EP 448 884, EP 640 385, EP 631 813, WO 90/02603, WO 97/24174, EP 665 041, EP 458 472, EP 476 938 und deutsches Gebrauchsmuster 298 07 007.3. Es ist aber auch möglich, den festen Katalysator als solchen oder in einer agglomerierten Form auf Destillationsböden auszubreiten. Im Verfahren werden die Verweilzeit, das Katalysatorvolumen und die destillative Trennwirkung im Reaktionsbereich auf die Reaktionskinetik und die Stoffübergangskinetik abgestimmt, wobei das Optimum der Parameter stark von den Randbedingungen wie z.B. vom gewählten Katalysator, dem Stoffsystem und den gewählten Druck- und Temperaturbedingungen abhängt.

Alternativ kann der Katalysator in externe, gegebenenfalls temperierte Reaktoren eingebracht werden, wobei wechselweise die Flüssigphase von der Reaktionskolonne in den Reaktor und von dort zur Stofftrennung wieder zurück in die Kolonne geführt wird. Hierbei wirkt sich jedoch nachteilig aus, daß entstehende Produkte im allgemeinen nicht so schnell nach ihrer Entstehung destillativ abgetrennt werden können, wie dies bei den vorgenannten Böden, Packungen und Füllkörpern der Fall ist. Zur Entkopplung unterschiedlicher Temperaturen innerhalb der Kolonne und in externen Reaktionen ist eine Temperierung der Stoffströme zwischen Kolonne und den Reaktoren möglich.

In Figur 3 ist der destillativ/reaktive Reaktionsbereich 2; 2a aus den Figuren 1 und 2 für die Ausführung mit extern angeordneten Reaktoren dargestellt. Das aus einem destillativen Teil 29 ablaufende flüssige Gemisch gelangt, gegebenenfalls über Wärmerückgewinnung und Temperierung 31 in einen von oben nach unten oder von

10

15

5

20

30

unten nach oben durchströmten Reaktor 32 und daraus auf den nächsten destillativen Abschnitt. Die Sequenz "destillativer Abschnitt-Temperierung-Reaktor" läßt sich beliebig oft übereinander anordnen.

Die im Reaktionsbereich der Reaktionskolonnen ablaufende Disproportionierung wird gemäß der Erfindung durch eine rein destillative Abtrennung und Reinigung der an Kopf und Sumpf der Reaktionskolonnen auszuschleusenden Silan bzw. Siliciumtetrachlorid enthaltenden Produkte ergänzt. Die destillative Trennung wird mittels der üblichen Einbauten für die reine Destillation wie Böden, Packungen und Füllder üblichen Einbauten für die ablaufende schwerer siedende SiCl₄-Komponente ist körpern durchgeführt. Für die ablaufende schwerer siedende SiCl₄-Komponente ist es günstig, durch rein destillative Abtrennung unterhalb des reaktiv/destillativen es günstig, durch rein destillative Abtrennung unterhalb des reaktiv/destillativen Reaktionsbereiches im unteren Bereich der Reaktionskolonne ein weitgehend aufkonzentriertes Siliciumtetrachlorid mit mehr als 70 % SiCl₄, vorzugsweise mehr 45 % SiCl₄, besonders bevorzugt mehr als 99 % SiCl₄ als Sumpfprodukt zu erzeugen und dieses dem Sumpf der Reaktionskolonne zu entnehmen.



Bezugszeichenliste

20 25 30	Dampfabzug Kopfkondensator SiH ₄ -Produktleitung Zweigleitung Inertgasleitung SiCl ₄ -Abfluß Trennkolonne Flüssigkeitspumpe Druckleitung Kompressor Abzug Kopfkondensator SiH ₄ -Produktleitung Zweigleitung Inertgasleitung Zweigleitung Inertgasleitung Sumpf Sumpf Sumpfabzug Zweigleitung Rückführung Wärmetauscher Ausschleusung Destillationsteil	2', 2a' 3, 3a 4, 4a 5, 5a 6, 6a 7, 7a 8, 8a 9, 9a 10, 10a 11, 11a 12, 12a 13, 13a 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
35	Wärmerückgewinnung Temperierung/Wärmetauscher Reaktor	29 30 31 32

Patentansprüche

Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Silan SiH_4 durch katalytische Disproportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid SiCl₄ in einem reaktiv/destillativen Reaktionsbereich mit Katalysator-1. bett aus katalytisch wirkendem Feststoff, in das SiHCl3 eingeführt wird und woraus im Katalysatorbett erzeugtes leichter siedendes SiH₄-haltiges Produkt abgeführt und in einem Kopfkondensator kondensiert und als Endprodukt abgeführt wird, und in dem als schwerer siedendes Sumpfprodukt SiCl₄ gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, daß das im Katalysatorbett unter einem Druck von 1 bis 50 bar erzeugte leichter siedende Produktgemisch bei einer Temperatur im Temperaturbereich von -25°C bis 50°C zwischenkondensiert und das dabei nicht kondensierte SiH4-haltige Produktgemisch im Kopfkondensator kondensiert wird.

15

5

10

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck im Kata-2. lysatorbett 1 bis 10 bar beträgt.

20

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenkondensation bei einer Temperatur im Temperaturbereich zwischen -5°C und 3. 40°C erfolgt.

25

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das an Kopfkondensator anfallende Produktgemisch bei einem gegenüber der Zwischen-4. kondensation erhöhtem Druck getrennt wird.

Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Chlorsilan zumindest zu einem Teil in den reaktiv/destillativen Reaktionsbereich 5. zurückgeführt wird.

5

10

15

20

25

30

Anlage zur Herstellung von Silan SiH₄ in kontinuierlicher Weise durch Dis-6. proportionierung von Trichlorsilan SiHCl₃ zu SiH₄ und Siliciumtetrachlorid SiCl₄ in einer Reaktionskolonne (1, 1a) mit einem reaktiv/destillativen Reaktionsbereich (2, 2a), der ein von Festkörpern aus katalytisch wirkendem Feststoff gebildetes, von den Disproportionierungsprodukten und Trichlorsilan durchströmbares Katalysatorbett (2', 2a') aufweist, mit einem Zulauf (3, 3a) für SiHCl₃ zum Reaktionsbereich, sowie mit einem an der Reaktionskolonne angeschlossenem Kopfkondensator (9, 9a) zur Kondensation von erzeugtem SiH₄-haltigen Produkt und einem Abzug für kondensiertes SiH₄ am Kopfkondensator (10, 10a), und mit einem Abfluß (13, 13a) an der Reaktionskolonne für als Sumpfprodukt anfallendes SiCl4, zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen reaktiv/ destillativem Reaktionsbereich (2, 2a) und Kopfkondensator (9, 9a) zumindest ein Zwischenkondensator (6, 6a) angeordnet ist, der bei einer Temperatur im Temperaturbereich von -25°C bis 50°C betrieben wird.

7. Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Zwischenkondensator (6, 6a) eine Temperatur im Temperaturbereich von -5°C bis 40°C eingestellt ist.

8. Anlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwischenkondensator (6, 6a) oberhalb des Katalysatorbettes (2', 2a') angeordnet ist.

9. Anlage nach einem der Ansprüche 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet. daß dem Zwischenkondensator (6, 6a) in Strömungsrichtung des vom Zwischenkondensator abströmenden leichter siedenden Produktgemisches ein Verstärkerteil (7, 7a) zur Erhöhung der SiH₄-Konzentration im Produktgemisch nachgeschaltet ist.

10. Anlage nach einem der Ansprüche 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß dem Zwischenkondensator (6a) in Strömungsrichtung des vom Zwischen-

kondensator abströmenden leichter siedenden Produktgemischs eine Trennkolonne (14) zur Trennung SiH₄-haltiger Produktanteile von schwerer siedenden Chlorsilan-Komponenten nachgeschaltet ist.

- 5 11. Anlage nach Anspruch 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Trenn-kolonne (14) dem Verstärkerteil (7a) nachgeschaltet ist.
 - 12. Anlage nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Verstärkerteil (7a) und Trennkolonne (14) ein Kondensator (9a) angeordnet ist.
 - Anlage nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennkolonne (14) bei einem gegenüber dem Zwischenkondensator (6, 6a) erhöhtem Druck arbeitet und das zur Trennkolonne (14) geführte Produkt komprimiert wird.
 - Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß am Sumpfabzug (24) der Trennkolonne (14) eine Zweigleitung (25) angeschlossen ist, die in den reaktiv/destillativen Reaktionsbereich (2a) der Reaktionskolonne (1a) mündet.



10

Verfahren und Anlage zur Herstellung von Silan

Zusammenfassung

Silan wird in ein kontinierliches Verfahren durch disproportionierung von Trichlorsilan in einem Katalysatorbett im Druckbereich von -20° bis 50°C hergestellt.





Fig.1

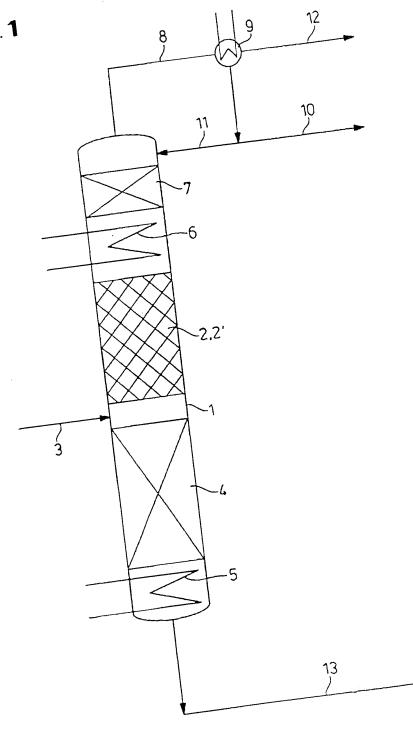


Fig. 2

